

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-357720
(43)Date of publication of application : 13.12.2002

(51)Int.Cl. G02B 5/30
G02B 27/26
G02F 1/1335

(21)Application number : 2002-067188 (71)Applicant : NIPPON KAYAKU CO LTD
NATIONAL INSTITUTE OF
ADVANCED INDUSTRIAL &
TECHNOLOGY
(22)Date of filing : 12.03.2002 (72)Inventor : MATSUNAGA DAISAKU
ICHIMURA KUNIHIRO
TAMAOKI TAKASHI

(30)Priority

Priority number : 2001074053 Priority date : 15.03.2001 Priority country : JP

(54) METHOD FOR MANUFACTURING NEW MICRO PATTERN POLARIZING ELEMENT AND THREE DIMENSIONAL LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To establish a method for manufacturing a micro pattern polarizing element having excellent partial orientation of a dichroic dye compound without necessitating extremely high positioning precision such as panel alignment.

SOLUTION: The method for manufacturing the polarizing element consists of steps of: forming a liquid crystalline polymer thin film with an optically active group on a substrate; irradiating the thin film with linearly polarized light; then irradiating the thin film with linearly polarized light with a different axis of polarization via a different mask with a micro pattern; and aligning the dichroic molecules on the thin film in a micro pattern. The dichroic molecule solution is applied with a printing machine with low printing pressure such as a roll coater, a flexographic machine, a screen printing machine, etc., so as to apply 0.05 to 1.0 Mpa pressure in a direction vertical to the substrate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 07.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-357720

(P2002-357720A)

(43)公開日 平成14年12月13日 (2002.12.13)

(51) Int.Cl. ¹	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 02 B 5/30		G 02 B 5/30	2 H 0 4 9
27/26		27/26	2 H 0 9 1
G 02 F 1/1335	5 1 0	G 02 F 1/1335	5 1 0

審査請求 未請求 請求項の数11 O.L (全31頁)

(21)出願番号	特願2002-67188(P2002-67188)
(22)出願日	平成14年3月12日 (2002.3.12)
(31)優先権主張番号	特願2001-74053(P2001-74053)
(32)優先日	平成13年3月15日 (2001.3.15)
(33)優先権主張国	日本 (JP)

(71)出願人	000004086 日本化薬株式会社 東京都千代田区富士見1丁目11番2号
(71)出願人	301021533 独立行政法人産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関1-3-1
(72)発明者	松永 代作 東京都港区芝浦4-4-27
(72)発明者	市村 國宏 神奈川県横浜市緑区藤ヶ丘2丁目23番16号
(74)代理人	100102668 弁理士 佐伯 繁生

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 新規なマイクロパターン偏光素子の製造方法及びこれを用いる立体表示液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】貼合のような極めて高い位置決め精度を必要とせず、二色性色素化合物の部分的配向に優れているマイクロパターン偏光素子の製造方法を確立すること。

【解決手段】基板上に光活性基を有する液晶性高分子薄膜を形成し、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に0.05 MPa～1.0 MPaの圧力がかかるように二色性分子溶液をロールコーラー、フレキソ印刷機、スクリーン印刷機のような印圧の低い印刷機を用いて塗布する偏光素子の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に光活性基を有する液晶性高分子薄膜を形成し、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に0.01 MPa～1.0 MPaの圧力がかかるように二色性分子溶液を塗布する偏光素子の製造方法

【請求項2】二色性分子溶液が、アニオン系界面活性剤を含む溶液である請求項1に記載の偏光素子の製造方法

【請求項3】請求項2におけるアニオン系界面活性剤が、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミンからなる群から選ばれる1種又は2種以上である請求項2に記載の偏光素子の製造方法

【請求項4】請求項1乃至請求項3における光活性基が、非芳香族性のN=N、非芳香族性のC=C、非芳香族性のC=Nからなる群から選ばれる1種又は2種以上である請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項5】請求項1乃至請求項3における液晶性高分子薄膜が、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル又はポリウレタン樹脂薄膜である請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項6】請求項1乃至請求項3における液晶性高分子薄膜が、ポリ桂皮酸ビニル樹脂薄膜である請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項7】請求項1乃至請求項3における二色性分子がリオトロピック液晶性を有する色素である請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項8】請求項7のリオトロピック液晶性を有する色素が親水性置換基を有する色素である請求項7の偏光素子の製造方法

【請求項9】請求項8において親水性置換基がスルホン酸基、カルボン酸基、アミノ基、水酸基からなる群から選ばれる1個以上の基である請求項8の偏光素子の製造方法

【請求項10】請求項1乃至請求項3における直線偏光の照射が偏光性を有するレーザ光を用いて行われる請求項1乃至請求項3の偏光素子の製造方法

【請求項11】対向する上下基板を有する液晶表示装置であって、該基板の少なくとも一方が請求項1乃至請求項10のいずれか一項に記載の偏光素子を有する基板である立体表示装置

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な高偏光率マイクロパターン偏光素子の製造方法及びその用途に関する。更には偏光軸が異なるマイクロパターン偏光素子及びそれを用いた立体視を可能にする立体表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来から偏光透過軸方向が異なる複数の偏光領域をパターン形成した偏光素子はいくつか知られている。例えば、特開昭62-96905号公報には延伸したポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布後パターン露光・現像してレジストをパターニングし、レジストで覆われていない延伸ポリビニルアルコールフィルム部分を二色性化合物で染色して所望パターンの偏光領域を形成する方法が提案されている。Sadeg M. Farisは1991年のSociety of Information and Display Conferenceにおいて、延伸した二色性ポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターニング後苛性ソーダ水溶液で溶解除去してパターン化した偏光フィルムを得、偏光軸の直交する二枚のパターン化偏光フィルムを重ね合わせてμPo1という偏光素子を作製し立体視に用いる方法を発表している(SID 91 DIGEST p840-843)。特開平7-261024号公報には基板上に塗布した光配向物質薄膜にパターン状に偏光を照射し、その上に二色性色素溶液を塗布配向させて所望のパターンの偏光領域を形成する方法が提案されている。特開平9-73015号公報には基板をフッ素樹脂の配向膜で被覆しその上にレジストを塗布し、パターニング後二色性色素を含む材料を積層して形成するマイクロパターン化偏光素子が提案されている。特開平10-160932号公報には複数の偏光片を隣接するもの同士の偏光透過軸を異なさせて基材に貼り付ける偏光素子が提案されている。特開平10-160933号公報には基材上に配置した偏光フィルムを部分的にダイサにて削って偏光透過軸を1方向に向けた短冊或いは格子状の部分偏光部材を形成し、この上に偏光軸が異なる方向に偏光フィルムを配置し、既にある偏光部材の上の部分の偏光フィルム部分をダイサにて削り取り複数の偏光透過軸を有する偏光素子、或いはダイサで削った部分偏光部材の偏光透過軸の異なるものを貼り合わせた偏光素子が提案されている。

【0003】一方画像の立体視に関しては、様々な方法が提案されており偏光を利用する二眼式立体視はその一つである。偏光眼鏡方式とも呼ばれるもので、右目、左目に各々偏光軸が直交する偏光板を使用した眼鏡をかけ、両眼視差を有する右目用、左目用の画像は各々光の偏波面を直交させ観察者の眼鏡の偏光板により左右の画像情報を各々左右の目に振り分けて観察する方式である。この方式において偏光方向の異なる画像を映し出すには、2台の表示装置や投影装置を用いて作られる画像をハーフミラー或いは偏光ミラーで合成する方法がとら

れている。この場合、表示装置が高価になり多数の観客に立体画像を見せる場合は適するが、家庭用或いは少人数で見るオフィス用その他ディスプレイには向かないという問題点を有していた。そこで同一面内に偏光軸が直交するマイクロパターン偏光素子を表示装置に用いれば、1台の表示装置中に右目用画像と左目用画像を同時に表示することが可能であり装置の価格も安価にする事が出来ると提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来から知られている偏光透過軸方向が異なる複数の偏光領域をパターン形成した偏光素子には、次のような問題点がある。特開昭62-96905号公報の方法では、延伸したPVAフィルムを染色するため通常の染色後延伸する方法よりも偏光能が低くなるだけでなくレジストを現像パターンングする際延伸PVAフィルムが膨潤し一軸性が損なわれ偏光能が更に低下してしまい結果的に満足な偏光率の偏光素子が得られないという問題がある。

【0005】Sadeq M. FarisがSociety of Infomation and Display Conferanceにおいて発表した方法(SID 91 DIGEST p840-843, USP5327285)では、延伸した二色性ポリビニルアルコールフィルム上にレジストを塗布し、パターンング後苛性ソーダ水溶液で溶解除去する際に残される偏光素子部分が膨潤するため偏光能が低下する事と偏光軸が直交する2種類の基板を貼り合わせて製造するため貼合の際に極めて高い位置決め精度が要求されるという問題がある。

【0006】特開平7-261024号公報の方法では、基板上に塗布した光配向物質の薄膜にパターン状に偏光を照射し、その上に二色性色素溶液を塗布配向させているが、これに関連して市村はMol. Cryst. Liq. Cryst., 1997, Vol. 298, pp221-226において以下のような報告をしている。この配向した色素膜を原子間力顕微鏡(STM)で観察してみると色素が均一に配向した部分と、色素が殆ど存在せずしかも配向していない部分(クレーター)が観察される。色素が均一に配向した部分と色素が殆ど存在せずしかも配向していない部分の吸光度を顕微分光光度計で測定し、このクレーターが多いため色素膜全体の均一性が低下し偏光能が不十分なものとなっていることが解った。本発明者等が配向している部分と配向していない部分の吸光度から二色性比(DR)を計算してみると、DR(a)≈3.0, DR(b)≈1.3と大きな差がありこれらを含めたより広い面積ではDR=5~6となり表示素子用としては満足できるレベルではなかった。なお、二色性比(DR)の計算は次による。

$$DR = A_{\parallel} / A_{\perp}$$

A_{\parallel} : 偏光軸が配向色素の分子長軸と平行な場合の吸光度。

A_{\perp} : 偏光軸が配向色素の分子長軸と垂直な場合の吸光度。

【0007】特開平9-73015号公報の方法では、基板をフッ素樹脂配向膜で被覆しその上にレジストを塗布し、パターンング後二色性色素を含む材料を積層してマイクロパターン化偏光素子を形成しているが、フッ素樹脂配向膜をレジストで処理した場合には現像後も表面に薄く残存するレジスト膜の影響か或いは現像処理の影響でフッ素樹脂配向膜の配向性が減殺されるためかその上に積層される二色性色素材料の配向性が十分ではなく偏光能が不十分であるという問題がある。

10 【0008】特開平10-160932号公報の方法では、複数の偏光片を隣接するもの同士の偏光透過軸を異なさせて基材に貼り付けて偏光素子を形成しているが、複数の偏光片の貼合の際極めて高い位置決め精度が要求されるという問題がある。特開平10-160933号公報の方法では、基材上に配置した偏光フィルムを部分的にダイサにて削って偏光透過軸を1方向に向けた短冊或いは格子状の部分偏光部材を形成し、この上に偏光軸が異なる方向に偏光フィルムを配置し既にある偏光部材の上の部分の偏光フィルム部分をダイサにて削り取り複数の偏光透過軸を有する偏光素子、或いはダイサで削った部分偏光部材の偏光透過軸の異なるものを貼り合わせて偏光素子を形成しているが、ダイサにて削る工程には極めて高い精度が要求され或いは偏光透過軸の異なった複数の部分偏光部材の貼合せの際極めて高い位置決め精度が要求されるという問題がある。

20 【0009】本発明者等は斯かる観点から、貼合せのような極めて高い位置決め精度を必要とせず、二色性色素化合物の部分的配向が優れているマイクロパターン偏光素子の製造方法を提供することを目的として鋭意検討し30 本発明に到了。本発明は、特開平7-261024号公報で開示された方法において、色素が殆ど存在せずしかも配向していない部分(クレーター)の発生を極力減らし二色性化合物の配向を全体的に高めて表示素子用として実用水準にある偏光素子を製造する方法に関するものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、二色性色素分子のマイクロパターン状異方的配列に更に適した光活性分子層及び二色性分子溶液の塗布方法について鋭意検討を行い、光活性基を結合させたポリアミド、ポリイミド、ポリエステル等の液晶性重縮合高分子やポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子或いは液晶性ポリ桂皮酸ビニル等の液晶性高分子が配向特性において優れた性能を示すことを見出した。本発明において光活性基を有する液晶性高分子薄膜を配向膜とし、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に特定の範囲の50 圧力が懸かるように二色性分子溶液を塗布する製造方法

によって、解像度が高く光軸の異なるパターン間のコントラストが極めて大きいマイクロパターン偏光素子を得ることが可能となった。

【0011】即ち、本発明は、(1) 基板上に光活性基を有する液晶性高分子薄膜を形成し、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、基板に対して垂直方向に0.01 MPa～1.0 MPaの圧力が懸かるように二色性分子溶液を塗布する偏光素子の製造方法、(2) 二色性分子溶液が、アニオン系界面活性剤を含む溶液である(1)に記載の偏光素子の製造方法、(3) (2)におけるアニオン系界面活性剤が、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミンからなる群から選ばれる1種又は2種以上である(2)に記載の偏光素子の製造方法、(4)

(1) 乃至 (3) における光活性基が、非芳香族性のN=N、非芳香族性のC=C、非芳香族性のC=Nからなる群から選ばれる1種又は2種以上である(1)乃至(3)の偏光素子の製造方法、

【0012】(5) (1) 乃至 (3) における液晶性高分子薄膜が、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル、ポリウレタン樹脂薄膜である(1)乃至(3)の偏光素子の製造方法、(6) (1) 乃至 (3) における液晶性高分子薄膜が、ポリ桂皮酸ビニル樹脂薄膜である(1)乃至(3)の偏光素子の製造方法、(7) (1) 乃至 (3) における二色性分子がリオトロピック液晶性を有する色素である(1)乃至(3)の偏光素子の製造方法、(8) (7) のリオトロピック液晶性を有する色素が親水性置換基を有する色素である(7)の偏光素子の製造方法、(9) (8) において親水性置換基がスルホン酸基、カルボン酸基、アミノ基、水酸基からなる群から選ばれる1個以上の基である(8)の偏光素子の製造方法、(10) (1) 乃至 (3) における直線偏光の照射が偏光性を有するレーザ光を用いて行われる(1)乃至(3)の偏光素子の製造方法、(11) 対向する上下基板を有する液晶表示装置であって、該基板の少なくとも一方が(1)乃至(10)のいずれか一項に記載の偏光素子を有する基板である立体表示装置、に関する。

【0013】液晶性高分子はある条件下で液晶性を示す高分子であるが、溶媒の存在下でいわゆるリオトロピック液晶性を示す高分子と、溶媒の介在なしに溶融状態で液晶構造を示すサーモトロピック液晶性高分子が知られている。一般に液晶性高分子は液晶状態で流動方向に分子の鎖が高度に配向した層を持ち、その配向状態を固定

化することで高強度・高弾性材料を得ている。その他、液晶性高分子薄膜の高度な配向性を利用して、低分子ネマチック液晶の配向膜とする研究も最近は多く見受けられる。

【0014】本発明において光活性基を有する液晶性高分子は、該高分子の薄膜の高度な配向性がその上に形成されるリオトロピック液晶性を有する二色性分子層の配向を十分に制御しうることを利用するものである。

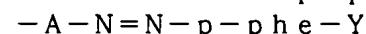
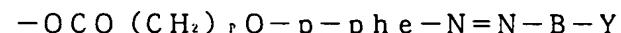
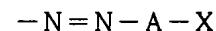
【0015】液晶化合物は様々な電場、磁場のような外場により配向することが知られている。電場、磁場による配向は良く知られていることである。その他にも流動配向と言われる液晶化合物自身の流れによっても配向する。又、ズリ応力を加えても力の方向に良く配向することが知られている。本発明において使用する二色性分子溶液もリオトロピック液晶状態で外的刺激の影響を受けて様々な配向をする事が観察されている。本発明では二色性分子溶液を塗布してマイクロパターン状に配列させるわけであるが、この目的に合致しない様々な外場の影響は極力避けなければならない事が分かった。

【0016】

【発明の実施の態様】以下、本発明について詳細に説明する。本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子は、直線偏光照射により光活性基の分子軸配向変化を起こす液晶性高分子のことである。ここで言う分子軸配向変化とは、直線偏光の光エネルギーを吸収した後に、その分子軸の方向がその直線偏光に応じて一定方向に変わることを意味する。

【0017】このような直線偏光照射により光活性基の分子軸配向変化を起こす性質を有する基は全て本発明における光活性基に含まれる。このような光活性基としては、例えばN=N、C=C、C=N、から選ばれた少なくとも一つの二重結合を含み、その二重結合が非芳香族性である基が挙げられる。

【0018】非芳香族性のN=N結合を有する基としては、アゾベンゼン基、アゾナフタレン基、ビスアゾ基、ホルマザン基等の芳香族アゾ基、更にはアゾキベンゼン基等を挙げることができる。これらの基の好ましいものとしては例えば下記式



(式中A及びBは置換基を有していてもよいベンゼン環又はナフタレン環を、Xは(C₁～C₁₀)のアルコキシ基又はジ(C₁～C₃)アルキルアミノ基を表し、ジアルキルアミノ基におけるアルキル基は両者同じでも又異なってもよく、また非置換又は片方若しくは両者がシアノ基若しくはヒドロキシ基で置換されていてもよい。Yは水素原子、フッ素原子、塩素原子、ニトロ基、シアノ基、(C₁～C₁₀)アルキル基、(C₁～C₁₀)アルコキシ基、(C₁～C₄)アルキルオキシカルボニルビニル基、

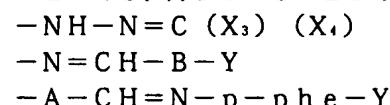
モノ若しくはジ ($C_1 \sim C_3$) アルキルアミノ基をそれぞれ表し、該モノ若しくはジ ($C_1 \sim C_3$) アルキルアミノ基のアルキル基は置換若しくは非置換何れでもよく、かつジ ($C_1 \sim C_3$) アルキルアミノ基の場合、2つのアルキル基は同じでも異なってもよい。また該アルキル基上の置換基としてはシアノ基又はヒドロキシ基等が挙げられる。シアノ基又はヒドロキシ基で置換されたモノ若しくはジ ($C_1 \sim C_3$) アルキルアミノ基としてはジヒドロキシエチルアミノ基、ヒドロキシ ($C_1 \sim C_3$) アルキルアミノ基、ジシアノエチルアミノ基又はシアノエチル ($C_1 \sim C_3$) アルキルアミノ基等が挙げられる。また p は1~10の整数を表し、 $p\text{h}\text{e}$ はベンゼン環を示し、 $p-p\text{h}\text{e}$ 又は $o-p\text{h}\text{e}$ はパラ位又はオルト位で隣原子と結合していることを示す。) で表される基が挙げられる。

【0019】非芳香族性の $C=C$ 結合を有する基としては、ポリエン、スチルベン、スチルバゾール、スチルバゾリウム、桂皮酸、イシジゴ、チオインジゴ、ヘミチオインジゴ等の有する基が挙げられる。これらの基の好ましいものとしては例えば下記式



(式中 X_1 及び X_2 は片方が水素原子を示し、他方が置換基を有してもよい芳香族6員環、($C_1 \sim C_3$) アルコキシカルボニル基を示すか、または X_1 及び (X_2) が結合し、 $-S-o-p\text{h}\text{e}-CO-$ で示される基を示す。 $o-p\text{h}\text{e}$ は前記と同じ意味を示し、置換基を有していてもよい。芳香族6員環及び $p\text{h}\text{e}$ 基上の置換基としては前記Yで記載したものなどが挙げられる。) で表される基が挙げられる。芳香族6員環としては、例えばY等の置換基を有しても良いベンゼン環、炭素原子で $-CH=C$ 基に結合するピリジン環等を挙げることができ、該ピリジン環は窒素原子上に、炭素数1ないし10のアルキル基で置換されていてもよい。

【0020】非芳香族性の $C=N$ 結合を有する基としては、芳香族シップ塩基、芳香族ヒドラゾン基等を挙げることができ、好ましいものとして下記式



* (式中 X_3 及び X_4 は片方が水素原子又は低級アルコキシカルボニル基を示し、他方が $-B-Y$ で示される基又は低級アルコキシカルボニル基を示すか、又は X_3 及び X_4 の両方が結合して、 $-CH=N-N$ (低級アルキル)- $CO-$ で示される基を示す。また、A、B、Y、 $p-p\text{h}\text{e}$ 等は前記と同じ意味を示す。) で表される基等が挙げられる。

【0021】これらの光活性基を有する液晶性高分子の吸収する光の波長は、可視光域のものにとどまらず紫外線や赤外線の領域のものも含まれる。これらの光活性基を有する液晶性高分子の薄膜に、該化合物が吸収する波長範囲を含む直線偏光を照射すると容易に分子軸配向変化を起こす。

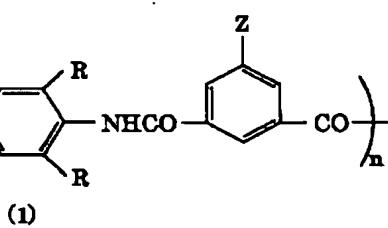
【0022】本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子としては例えば光活性基を結合させたポリアミド、同ポリイミド、同ポリエスチル等の液晶性重縮合高分子や光活性基を結合させたポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子及び液晶性ポリ桂皮酸ビニル等を挙げができる。該液晶性高分子は、光活性基を有する単量体を反応させたホモポリマー、光活性基を有する単量体と光活性基を持たない単量体好ましくは同種の単量体とを反応させたコポリマーのいずれでもよい。該コポリマーの場合、光活性基を有する単量体1モルに対して、光活性基を持たない単量体好ましくは同種の単量体を100モル以内の割合で重合させたポリマーが好ましく、より好ましくは光活性基を持たない同種の単量体50モル以内の割合で重合させたポリマーが好ましい。

【0023】該液晶性高分子の具体的な例としては下記一般式(1)~(4)で示される部分構造を有し、かつ高分子全体が実質的にこの部分構造から構成されているホモポリマー又は液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマー、又は該部分構造若しくは桂皮酸ビニルに対応する部分構造をモル割合で、ほぼ1%以上、より好ましくは2%以上含むコポリマーを挙げることが出来る。液晶性高分子化合物の具体的な例として次のような化合物を挙げることが出来る。

【0024】下記一般式(1)

【0025】

【化1】



【0026】(式中Rはメチル基、エチル基、*i*-プロピル基又は塩素原子を、nは5~10000の整数をそれぞれ表す。Zは下記式(a)~(e)で示される基を表す。)

【0027】(a) $-N=N-A-X$

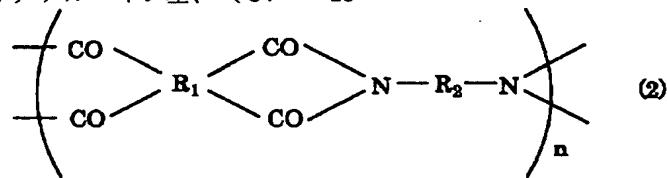
(b) $-CH=C(X_1)(X_2)$

(c) $-NH-N=C(X_3)(X_4)$

(d) $-N=C\text{H}-B-Y$

(e) $-\text{O}(\text{CO}(\text{CH}_2)_p\text{O}-\text{p-phenyl-}=\text{N}-\text{N-B}-\text{Y}$

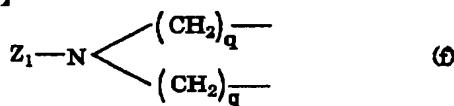
【0028】(式中Aは置換基を有していてよいベンゼン環又はナフタレン環を、Xは(C₁～C₁₀)のアルコキシ基又はジ(C₁～C₃)アルキルアミノ基を表し、ジアルキルアミノ基におけるアルキル基は両者同じでも又異なってもよく、また非置換又は片方若しくは両者がシアノ基若しくはヒドロキシ基で置換されていてよい。またX₁及びX₂は片方が水素原子を示し、他方が置換基を有していてよい芳香族6員環、(C₁～C₃)アルコキシカルボニル基を示すか、又はX₁及びX₂が結合し、-S-o-phe-CO-で示される基を示す。また、X₃及びX₄は片方が水素原子又は低級アルコキシカルボニル基を示し、他方が-B-Yで示される基又は低級アルコキシカルボニル基を示すか、又はX₃及びX₄の両方が結合して、-CH=N-N(低級アルキル)-CO-で示される基を示す。また、Bは置換基を有していてよいベンゼン環又はナフタレン環を、Yは水素原子、フッ素原子、塩素原子、ニトロ基、シアノ基、(C₁～C₁₀)アルキル基、(C₁～C₁₀)アルコキシ基、(C₁～



【0031】(式中R₁は脂環式又は芳香環テトラカルボン酸の残基、n'は2~10000の整数を示し、R₂は下記式(f)又は式(g)で表される光活性基を有する基を示す。

〔0032〕

【化3】



【0033】(式中乙)は

(f - a) $Y - p - p \text{h} e - N = N - B_o -$
 (f - b) $Y - p - p \text{h} e - N = C H - B_o -$
 (f - c) $Y - p - p \text{h} e - C H = N - B_o -$
 (f - d) $(X_1) (X_2) C H = C H - B -$

で表される基を示し、 B_0 は B 又は $-C_6H_4O (CH_2)$ 、
 $pCOO-B-$ を示し、式中の Y 、 $p-phen.$ 、
 (X_1) 、 (X_2) 、 B 及び p の各記号は前記と同じ意味
 を示す。また q は $2 \sim 4$ の整数を示す。) 又は下記式

$$(1)$$

(g)

〔0034〕

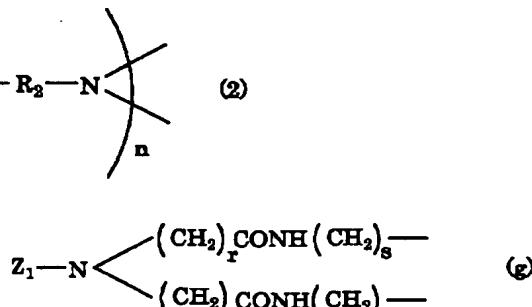
〔化4〕

* C₄) アルキルオキシカルボニルビニル基、モノ若しくはジ (C₁～C₃) アルキルアミノ基を表し、該モノ若しくはジ (C₁～C₃) アルキルアミノ基のアルキル基は置換若しくは非置換何れでもよく、かつジ (C₁～C₃) アルキルアミノ基の場合、2つのアルキル基は同じでも異なってもよい。また該アルキル基上の置換基としてはシアノ基又はヒドロキシ基等が挙げられる。シアノ基又はヒドロキシ基で置換されたモノ若しくはジ (C₁～C₃) アルキルアミノ基としてはジヒドロキシエチルアミノ基、ヒドロキシ (C₁～C₃) アルキルアミノ基、ジシアノエチルアミノ基、またはシアノエチル (C₁～C₃) アルキルアミノ基等が挙げられる。またpは1～10の整数を表し、p-h_eはベンゼン環を示し、p-p-h_e又はo-p-h_eはパラ位又はオルト位で隣接原子と結合していることを示す。) で表される部分構造を有するポリアミド化合物。

【0029】下記一般式 (2)

【0030】

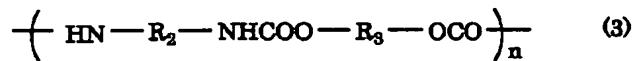
【化2】



【0035】(式中 Z_1 は前記と同じ意味を示し、 r は 1～5 の整数、 s は 2～8 の整数をそれぞれ示す。) で表される部分構造を有するポリイミド化合物、下記一般式(3)

[0036]

【化5】



0

1

【0037】(式中 R_2 は前記一般式(2)におけると同じ意味を表し、 R_3 は $-(CH_2)_m-$ を表し、 m は 2 ～ 8 を表す。 n は 5 ～ 10000 の整数を表す。) で表される部分構造を有するポリウレタン化合物、下記一般式(4)

[0038]

【化6】

つ縮合環が、架橋基を介して又は介さずして、2つ結合したテトラカルボン酸等が挙げられる。架橋基としては特に制限はないが、低級アルキレン基、CO、窒素原子、酸素原子などである。

【0042】又、上記(4)の液晶性桂皮酸ビニルのホモポリマーは桂皮酸ビニルモノマーを重合させることにより得られる。コポリマーを得る場合には適当な共重合可能なかつ液晶性を阻害しないかつ光活性基を有しない単量体と共に重合することにより、所望のコポリマーからなる液晶性高分子を得ることが出来る。桂皮酸ビニルモノマーと光活性基を有しない単量体との使用割合を変えることにより高分子化合物中の光活性基の結合量を調節することが出来る。コポリマーを得るために、桂皮酸ビニルモノマーと共重合させる光活性基を有しない単量体としては例えば4-(4'-n-ペンチルフェニル)スチレン、4-(4'-n-ヘキシルフェニル)スチレン、4-(4'-n-ペンチルシクロヘキシル)スチレン、4-(4'-n-ヘキシルシクルヘキシル)スチレン等が挙げられる。

10

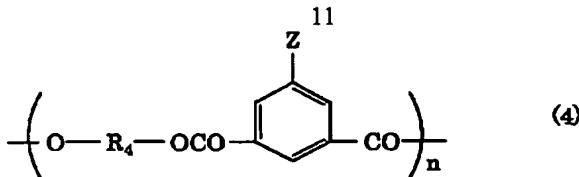
20

30

30

40

50



【0039】(式中Zは前記一般式(1)と同じ意味を示す。また、R₄はベンゼン環、ナフタレン環、C₄～C₆メチレン基(テトラメチレン基及びヘキサメチレン基等)を表し、nは5～10000の整数を表す。)で表される部分構造を有するポリエステル化合物。

【0040】上記において好ましいものとしては下記のものを挙げる事が出来る。

(1) 一般式(1)においてはZが前記(a) -N=N-A-X又は前記(e) -OCO(CH₂)₃O-p-phen-N=N-B-Yである部分構造を有するポリアミド化合物。

(2) 一般式(2)及び(3)においては、(f)又は(g)におけるZ₁がY-p-phe-N=N-A-である部分構造を有するポリイミド化合物又はポリウレタン化合物。

(3) 一般式(4)の部分構造を有するポリエステル化合物。

(4) 液晶性ポリ桂皮酸ビニルのホモポリマー又はコポリマー。

【0041】これらの中、上記(1)～(3)のポリアミド化合物、ポリイミド化合物及びポリエステル化合物のような液晶性重縮合高分子及びポリウレタンのような液晶性重付加反応高分子は、光活性基を有する二官能単量体を用意し、もう一方の官能単量体とを等モルで反応させて所望の液晶性高分子(ホモポリマー)を得る事が出来る。コポリマーを製造するときには、光活性基を有する二官能単量体と共に例えは光官能基を有しない同種の二官能単量体を併用し、上記同様に等モルで反応させることにより所望のコポリマーからなる液晶性高分子を得ることが出来る。光活性基を有する単量体と光活性基を有しない同種の単量体との使用割合を変えることで高分子化合物中の光活性基の結合量を調節することが出来る。光活性基を有する二官能単量体と反応させる光活性基を有しないもう一方の二官能単量体としては例えば4,4'-ジアミノ-3,5,3',5'-テトラR置換ジフェニルメタン(Rは前記一般式(1)におけるのと同じ意味を示す)、脂環式又は芳香環テトラカルボン酸、炭素数2～8の脂肪族ジカルボン酸等を挙げることが出来る。脂環式又は芳香環テトラカルボン酸としては炭素数4～6員環の脂環式又は芳香環テトラカルボン酸、炭素数8～10の縮合環上に4つのカルボキシル基を持つ縮合環テトラカルボン酸又は2つのカルボキシル基を有する炭素数4～6員環の脂環式又は芳香環若しくは炭素数8～10の縮合環上に2つのカルボキシル基を持

【0043】光活性基を有する二官能単量体と、コポリマーを得るために該光活性基を有する二官能単量体と共に反応させる光活性基を有しない単量体との使用割合は単量体の構造にもよるが、1:0から1:100、より好ましくは1:0から1:50の範囲である。

【0044】重合反応はポリアミド化合物、ポリイミド化合物、ポリウレタン化合物又はポリエステル化合物、ポリ桂皮酸ビニル重合体を得る従来公知の方法に準じて、通常溶媒中での溶液重合法等で行えばよい。

【0045】上記のようにして得られる本発明で使用する光活性基を有する液晶性高分子はその重合度等については特に制限はなく、樹脂の種類、光活性基の種類等により異なるので一概には言えないが、通常2以上、好ましくは5以上、更に好ましくは10以上～10000程度である。

【0046】光活性基を有する二官能単量体としては、例えは光活性基をベンゼン環上に有するオルトフタル酸、2個のアルキル基で置換されている窒素原子が更に光活性基で置換されているジ[アミノ(C₂～C₄)アルキル]アミン等が挙げられる。

【0047】本発明で使用される液晶性高分子の原料となる光活性基を有する二官能単量体の具体例を次に示すが、これらは単なる例示であり、これらに限定されるものではない。

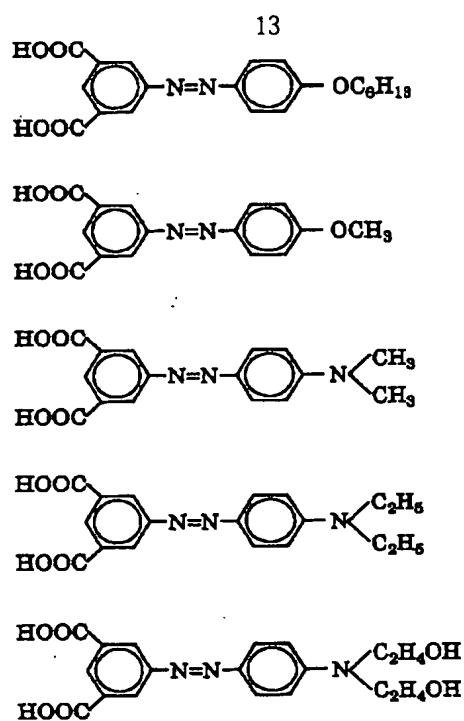
【0048】(1)光活性基として非芳香族性のN=N結合を有する基を持つ単量体としては下記する物が挙げられる。

①ポリアミド化合物又はポリエステル化合物用に適する単量体

【0049】

【化7】

(8)



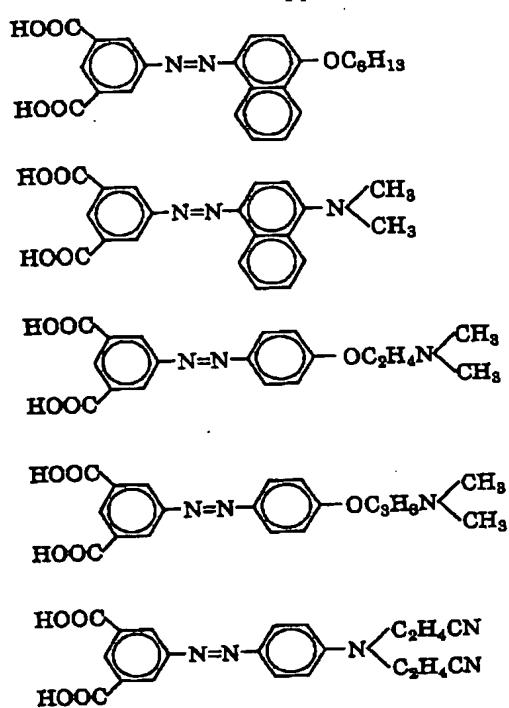
10

20

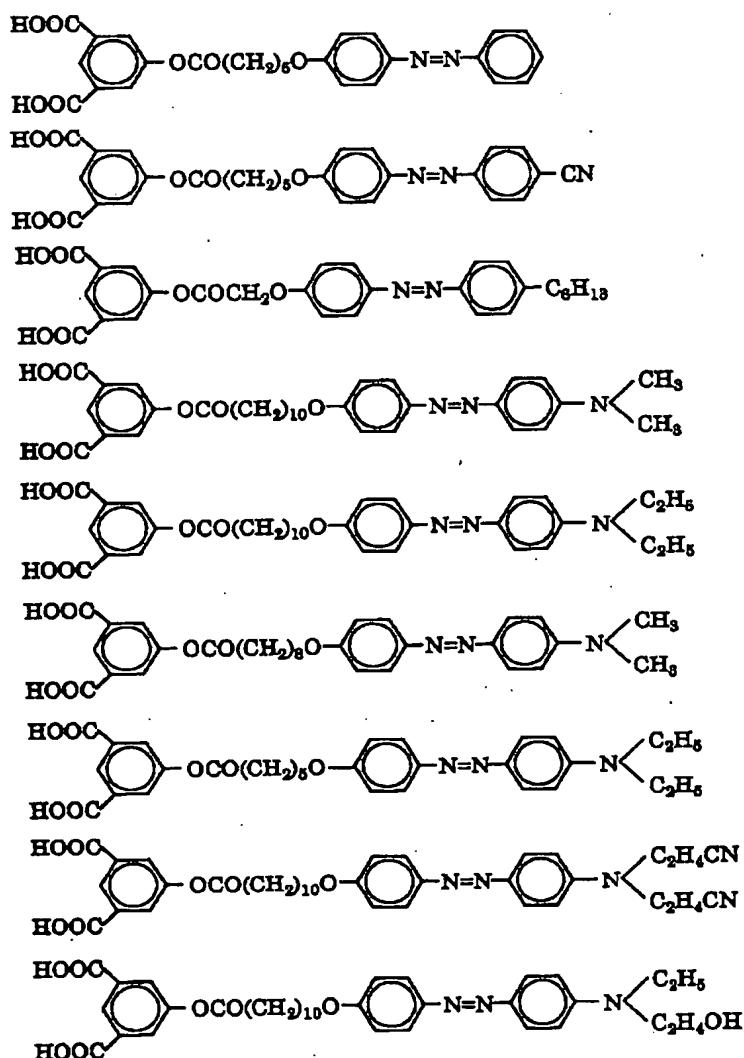
【0050】
【化8】

特開2002-357720

14



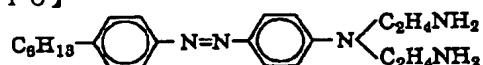
【0051】
【化9】



【0052】②ポリイミド化合物又はポリウレタン化合物に適する单量体

【0053】

【化10】

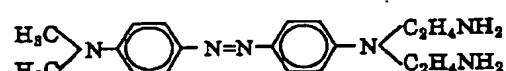
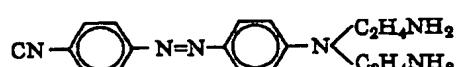


【0054】

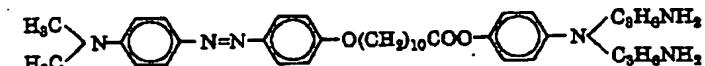
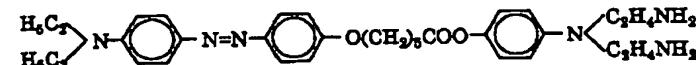
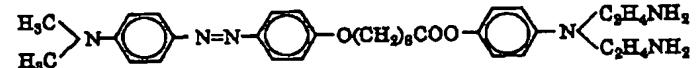
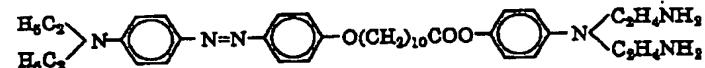
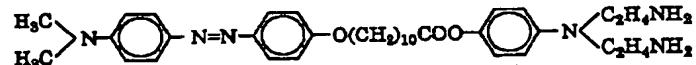
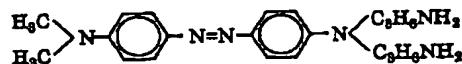
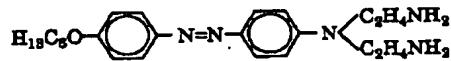
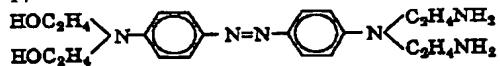
【化11】



40



17



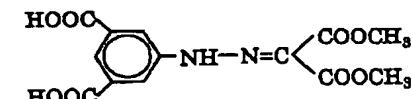
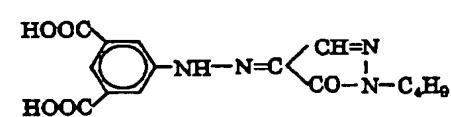
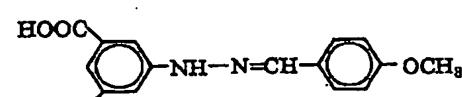
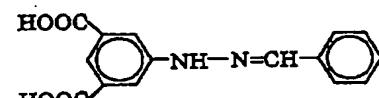
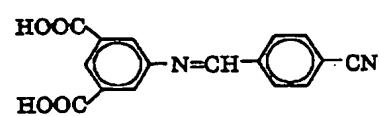
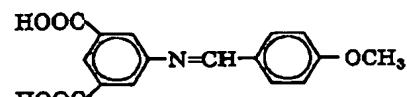
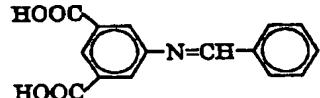
【0055】(2) 光活性基として非芳香族性の C=N 結合を有する基を持つ单量体としては下記する物が挙げられる。

①ポリアミド化合物又はポリエステル化合物用に適する单量体

【0056】

【化12】

30

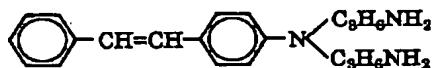
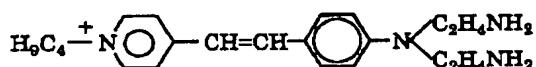
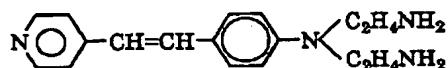
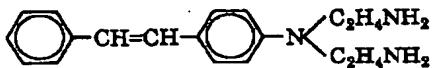
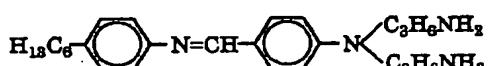
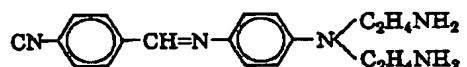
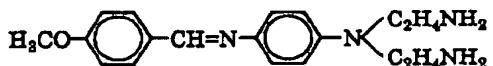


40

【0057】②ポリイミド化合物又はポリウレタン化合物に適する单量体

【0058】

【化13】

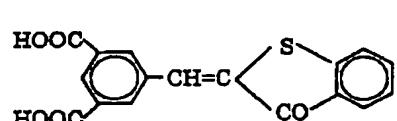
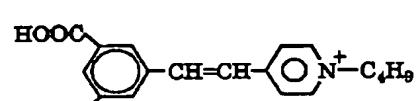
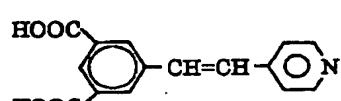
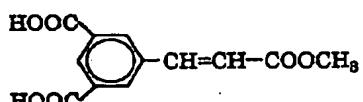
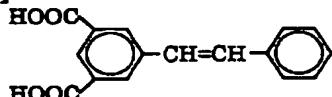


【0059】(3) 光活性基として非芳香族性の $C=C$ 結合を有する基を持つ单量体としては下記する物が挙げられる。

①ポリアミド化合物又はポリエステル化合物用に適する单量体

【0060】

【化14】



【0061】②ポリイミド化合物又はポリウレタン化合物に適する单量体

【0062】

【化15】

【0063】このような光活性基を有する液晶性高分子化合物の薄膜を基板上(基板としては、ガラス、或いはポリカーボネート、ポリエステルのようなプラスチック基板が用いられる)に設ける方法としては、回転塗布法が好ましい。又、この種の液晶性高分子薄膜をラングミュアープロジェット法によって基板上に設けても良い。更には、これらの液晶性高分子溶液に基板を浸漬して吸着させても良い。膜厚は、通常 $0.001 \sim 5 \mu m$ 、好ましくは $0.01 \sim 1 \mu m$ である。これらの薄膜を設ける場合、通常該液晶性高分子を適当な溶媒に溶解し、液晶性高分子溶液として使用する。溶液中の該液晶性高分子の濃度は該液晶性高分子の種類、重合度、塗布方法、希望する膜厚等により適当な濃度は異なるので一概に言えないが、通常 0.1 重量% ~ 10 重量% 程度であり、好ましくは 0.5 重量% ~ 5 重量% 程度である。適当な濃度は使用する塗布方法で予備的な試験をして容易に決定することが出来る。使用される溶媒としては該液晶性高分子を溶解するものであれば特に限定されないが、ピリジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルフォキシド、N-メチルピロリジノン、ジメチルアセトアミド、ジメチルイミダゾリン等の非プロトン性極性溶媒が好ましい例として挙げられる。

【0064】基板上に設けられた光活性基を有する液晶性高分子の薄膜に直線偏光を照射する方法としては公知の様々な方法が適用できる。マイクロパターン偏光素子を製造するためには、偏光パターンを光活性基を有する液晶性高分子薄膜に焼き付ける事が必要であり、そのためには希望するマスクパターンを通して直線偏光を該薄膜に照射すればよい。或いは、偏光性を有するレーザ光をレンズ等を用いて集光し、それを操作してパターン状に照射すればよい。露光エネルギーは $0.1 mJ/cm^2$ から $10 mJ/cm^2$ の範囲が好ましい。該薄膜の直線偏光照射による分子軸配向変化は可逆的であり、マスクパ

ターン毎に異なる偏光軸の直線偏光を照射することによりパターンを自由に重ね書きすることが出来る。尚、複雑なパターンを有する偏光素子（板）を一枚製造すれば、その偏光素子（板）をマスクパターンとして使用することで従来困難であった複雑なパターンを有する偏光素子（板）を直線偏光照射という簡便な方法で多数製造することが出来る。

【0065】このようにして得られる一定方向に分子軸の配列した光活性基を有する液晶性高分子薄膜に二色性色素分子をマイクロパターン状に塗布するだけで、即ち、該薄膜上に二色性色素層をマイクロパターン状に設けるだけで、二色性色素分子の分子軸が光活性基の分子軸の配列方向、即ち該薄膜に照射した直線偏光の偏光軸で規定された方向に配列し、かつ偏光軸が固定されてマイクロパターン偏光素子としての性質が発揮される。この事を更に具体的に説明すると、一定方向に分子軸の配列した光活性基を有する液晶性高分子薄膜を有する基板上に、二色性色素の溶液を塗布し、所望の温度・湿度条件下に溶媒を蒸発させマイクロパターン状の該色素薄膜を形成する。この際該色素の分子軸は、光活性基を有する液晶性高分子薄膜に照射した直線偏光の偏光軸で規定された方向に配列し該色素薄膜の光の吸収軸が固定されてマイクロパターン偏光素子としての性質が発揮される。

【0066】本発明で用いる二色性色素溶液は、塗布の際に基板に平行なズリ応力を加えるとその応力方向に配向し易い性質を持っている。光配向のための配向潜像を作製した基板であっても、二色性色素溶液の塗布の際にズリ応力が加わった部分はズリ応力による配向規制力が光配向規制力を上回ってしまうため光配向のマイクロパターンが見えなくなってしまう事が分かった。従って、光配向規制力を優先させマイクロパターンの配向を実現するためには、塗布時の基板に平行なズリ応力を如何に軽減するかが重要な技術となる事が分かった。即ち、光活性基を有する液晶性高分子薄膜を配向膜とし、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子溶液を塗布する工程において、基板に対して平行なズリ応力が加わらず且つ垂直方向に0.01 MPa～1.0 MPa、好ましくは0.05 MPa～0.5 MPaの圧力がかかるように二色性分子溶液を塗布する製造方法によって、解像度が高く光軸の異なるパターン間のコントラストが極めて大きいマイクロパターン偏光素子を得ることが可能となった。このような圧力を制御する上で有利な塗工方法としてはロールコーナー塗布、フレキソ印刷、スクリーン印刷、カーテンコーナー塗布、スプレイコーナー塗布等があるが、特にロールコーナー塗布、カーテンコーナー塗布、スプレイコーナー塗布等が好ましい。

【0067】本発明で用いる二色性色素（分子）溶液

は、一定の濃度及び温度範囲において液晶性を示す。ある種の界面活性剤は二色性色素溶液のネマチック液晶性を高める効果を示した。芳香族化合物である二色性色素は液晶相ではカラム積層構造をとっている。界面活性剤もリオトロピック液晶相を示すことが知られているが芳香族化合物のリオトロピック液晶相とは異なった相をとる場合が多い。そのため界面活性剤を含む二色性色素溶液が高濃度になると色素液晶相と界面活性剤液晶相とが相分離を起こし色素を含まない界面活性剤のみの領域が生じる。この現象は、二色性色素溶液の塗布膜において色素の無いピンホールとして観察されるが、これは界面活性剤、特にアニオン界面活性剤により顕著に改善される。アニオン界面活性剤のうちでも好ましい物は、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、好ましくはアルカリ金属塩または低級アルカノールアミン塩、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム（エマール20C、エマールE-27C、エマールE-70C等：いずれも商品名：花王（株）製）及び他のポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウムとしては例えばエマール20CM、レベノールWX、ラテムルWX等（いずれも商品名：花王（株）製）、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン（エマール20T（商品名）等、花王（株）製）、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、好ましくはアルカリ金属塩 例えばポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム（エマールNC-35、レベノールWZ等、いずれも商品名：花王（株）製）、ラウリル硫酸塩、好ましくはラウリル硫酸アルカリ金属塩、アンモニウム塩または低級アルカノールアミン塩 例えばラウリル硫酸ナトリウム（エマール10、エマール0等、花王（株）製）、ラウリル硫酸アンモニウム（エマールAD-25R、エマールAD-25等、いずれも商品名：花王（株）製）、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、高級アルコール硫酸塩、好ましくは高級アルコール硫酸アルカリ金属塩、例えば高級アルコール硫酸ナトリウム（エマール40パウダー（商品名）等、花王（株））等である。光活性基を有する液晶性高分子薄膜を配向膜とし、該薄膜に直線偏光を照射し、ついで別のマイクロパターン状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を照射した後、該薄膜上に二色性分子をマイクロパターン状に配列させる工程において、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミンから選ばれた1つ又は2つ以上の界面活性剤を含有した二色性色素溶液を基板に対して平行なズリ応力が懸からないように塗布する製造方法によって、解像度が

高く光軸の異なるパターン間のコントラストが極めて大きいマイクロパターン偏光素子を得ることが可能である。好ましい界面活性剤の添加量は、二色性色素溶液中0.01重量%~1重量%、より好ましくは0.05重量%~0.5重量%の範囲で含有させる。

【0068】二色性色素を溶解する溶媒としては、水、アルコール類、エーテル類、ピリジン、ジメチルホルムアミド(DMF)・ジメチルスルフォキシド(DMSO)・N-メチルピロリジノン(NMP)・ジメチルアセトアミド(DMAC)・ジメチルイミダゾリン(DMI)等の非プロトン性極性溶媒が好ましい。特に水を主体とする混合溶媒が好ましい。有機溶媒の混合量は任意であるが、0~70重量%特に0~50重量%が好ましい。好ましい二色性色素の濃度は二色性色素溶液全体に對して通常30重量%以下、好ましくは20重量%以下、より好ましくは15重量%以下程度で、通常0.1重量%以上、好ましくは0.5重量%以上、より好ましくは0.8重量%以上である。二色性色素溶液の溶媒を蒸発させ該色素薄膜を形成する温度・湿度条件は、該色素薄膜の偏光素子としての性能を左右する重要な条件である。この条件は、溶媒組成・色素の種類・色素濃度・塗工膜厚等により決められるが、温度は0~200℃、好ましくは5~50℃、湿度は20~80%RH、好ましくは40~70%RH程度である。

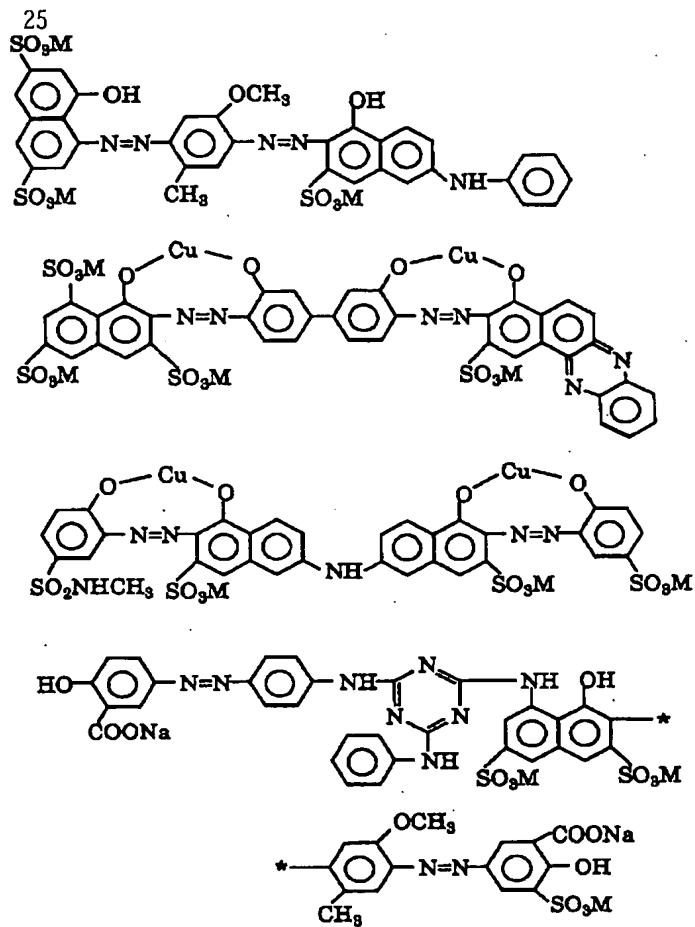
【0069】本発明で用いられる二色性色素は、一定の溶媒組成・色素濃度・温度条件下でリオトロピック液晶性を示す化合物でありクロモニック液晶相といわれる会合した集合体を形成しており、この集合体が一定方向に配列することにより、偏光性を示す。又、複数の分子が会合しているために耐光堅牢性に優れるという特徴を有している。例えば芳香族系環構造としては、ベンゼン、ナフタリン、アントラセン、フェナントレンの他にチアゾール、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、キノリ

ン等の複素環或いはこれらの4級塩、更にはこれらとベンゼンやナフタリン等との縮合環が特に好ましい。又、これらの芳香族系環にスルホン酸基、カルボン酸基、アミノ基、水酸基等の親水性置換基が導入されていることが好ましい。

【0070】二色性色素としては、例えばアゾ系色素、シアニン系色素、インダンスロン等の縮合系を含むアントラキノン系色素、スチルベン系色素、ピラゾロン系色素、ペリレン系色素、ナフタルイミド系色素、トリフェニルメタン系色素、キノリン系色素、オキサジン系色素、チアジン系色素、キノフタロン系色素、インジゴ系色素、チオインジゴ系色素等が挙げられる。水溶性の色素が好ましいがこの限りではない。二色性色素の具体例としては、例えばC.I. Direct Blue 1, C.I. Direct Blue 15, C.I. Direct Blue 67, C.I. Direct Blue 78, C.I. Direct Blue 83, C.I. Direct Blue 90, C.I. Direct Blue 98, C.I. Direct Blue 151, C.I. Direct Blue 168, C.I. Direct Blue 202, C.I. Direct Green 51, C.I. Direct Green 59, C.I. Direct Green 85, C.I. Direct Vioet 9, C.I. Direct Vioet 48, C.I. Direct Red 2, C.I. Direct Red 39, C.I. Direct Red 79, C.I. Direct Red 81, C.I. Direct Red 83, C.I. Direct Red 89, C.I. Direct Orange 39, C.I. Direct Orange 41, C.I. Direct Orange 49, C.I. Direct Orange 72, C.I. Direct Yellow 12, C.I. Direct Yellow 26, C.I. Direct Yellow 44, C.I. Direct Yellow 50, C.I. Acid Red 37, C.I. No. 27865, C.I. No. 27915, C.I. No. 27920, C.I. No. 29058, C.I. No. 29060, disulfoindanthrone, disulfo-N,N'-dixylylperylene tetra carbodiimide等が挙げられる。次にいくつかの具体例を構造式でもって次に示す。

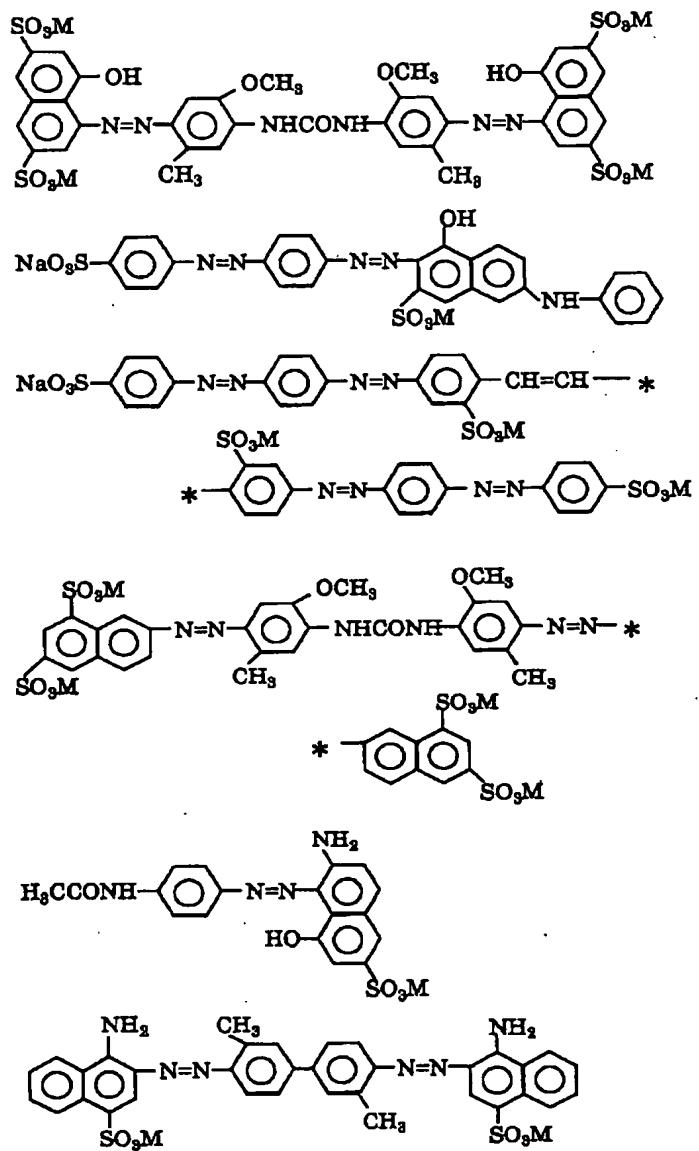
【0071】

【化16】



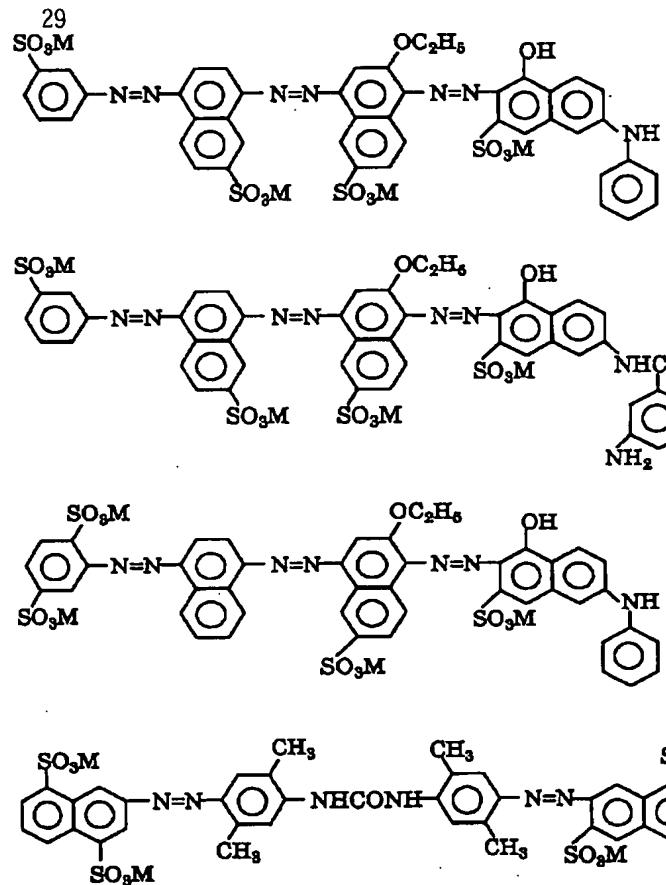
【0072】

【化17】



【0073】

【化18】

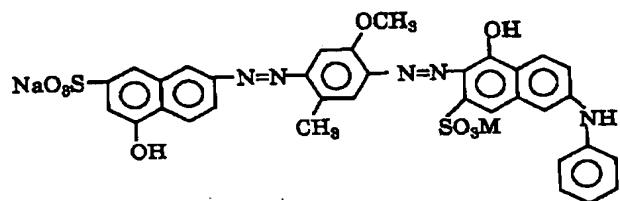
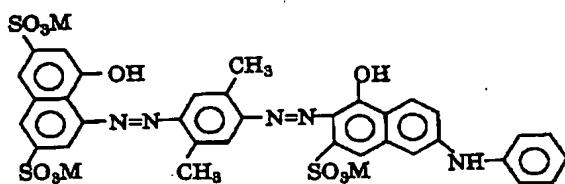
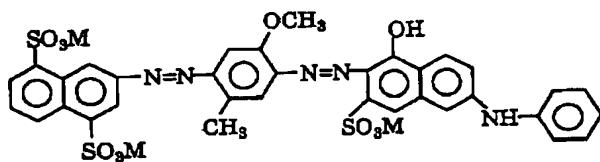
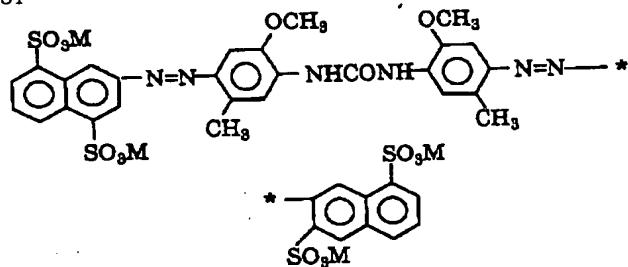


【0074】

【化19】

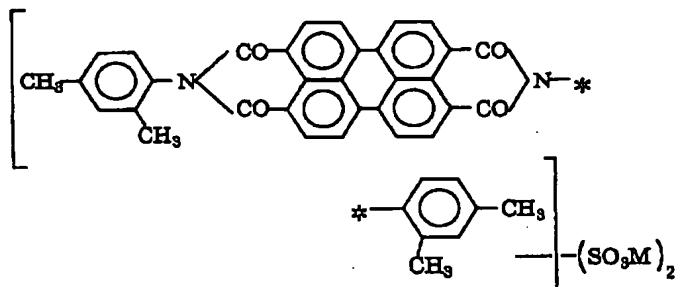
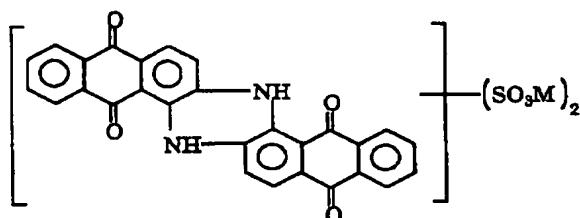
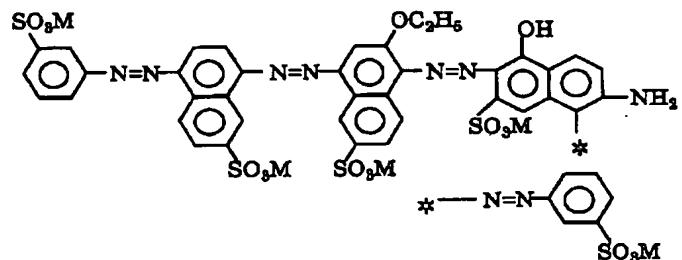
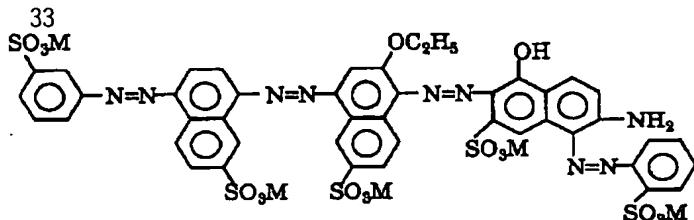
31

32



【0075】

【化20】



【0076】

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例中、部は特に限定しない限り重量部を表す。又、%は断りのない限り重量%を意味する。

【0077】実施例1

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射
下記ポリアミド化合物(1)精製品2部をNMP9.8部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンドルコートし、100℃にて2時間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高压水銀ランプ(500W/h·r)を使用し500nmカットオフフィルターで可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0078】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 5部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水9.4.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.3MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。

40 塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。その可視吸収スペクトルを図1に示す。吸収極大波長における二色性比は、2.5であった。

【0079】ポリアミド化合物(1)の合成

NMP5.0部中に5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)イソフタル酸3.1部、4,4'-ジアミノ-3,5,3',5'-テトラエチルジフェニルメタン(TEDPM:日本化薬(株)製)3.1部を加え攪拌溶解する。次いでトリフェニルfosfait 9.3部、ピリジン2.4部を加え、100℃にて10時間攪

50 湧して、析出する沈殿をろ過、水洗、乾燥して得る。

拌反応する。反応終了後水50部を加え、上澄み液をデカンテーションで除き2%炭酸ソーダ水溶液100部を加え一晩攪拌し、結晶化させる。生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリアミド化合物(1)(ポリ{イミノ-5-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ]イソフタロイルイミノ-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレンメチレン-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレン})5.9部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈し再沈殿精製する。

【0080】ポリアミド化合物(1)の原料として使用した5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)イソフタール酸の合成

氷水100部中に5-アミノイソフタール酸9.05部、6N塩酸17部を加え氷水で冷却する。亜硝酸ソーダ3.45部を水10部に溶解し、5℃以下で添加してジアゾ化する。別に、N,N-ジメチルアニリン6.3部、6N塩酸8.5部、氷水60部のカッピング溶液を調製し氷水で冷却する。このカッピング溶液中に5℃以下で上記ジアゾニウム溶液を添加し、2%炭酸ソーダ溶液を加えてpH4~6を保ちながら10℃以下で終夜攪拌する。析出した結晶を濾過し水洗乾燥してモノアゾ色素5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)イソフタール酸15.5部を得る。

【0081】実施例2

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射下記ポリアミド化合物(2)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例1に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0082】会合性二色性色素膜の作製1

C.I. Direct Blue 67 5部、エマール20C(アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水94.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0083】会合性二色性色素膜の作製2

Benzopurpurine 4Bを1部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水98.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロ

ルコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。その可視吸収スペクトルを図2に示す。吸収極大波長における二色性比は、30であった。

【0084】ポリアミド化合物(2)の合成

10 NMP50部中に5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシウンデカノイルオキシ)イソフタール酸5.9部、4,4'-ジアミノ-3,5,3',5'-テトラエチルジフェニルメタン(TEDPM)3.1部を加え攪拌溶解する。次いでトリフェニルfosfait9.3部、ピリジン2.4部を加え、100℃にて10時間攪拌反応する。反応終了後水30部を加え、上澄み液をデカンテーションで除き2%炭酸ソーダ水溶液100部を加え一晩攪拌し、結晶化させる。生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリアミド化合物(2)(ポリ{イミノ-5-[4-ジメチルアミノフェニルアゾ]フェノキシウンデカノロキシ)イソフタロイルイミノ-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレンメチレン-1,4-(3,5-ジメチル)フェニレン})8.7部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈し再沈殿精製する。

【0085】ポリアミド化合物(2)の原料として使用した5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシウンデカノイルオキシ)イソフタール酸の合成4-オキシ(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)ベンゼンと1,1-ブロモウンデカン酸より合成した

30 4-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシウンデカン酸8.5部と塩化チオニル9.6部をトルエン30部で室温で5時間攪拌反応させる。その後減圧下に過剰の塩化チオニルを留去し、氷水で冷却しながら5-オキシイソフタール酸ジテトラピラニルエステル7.5部とピリジン9.6部を溶解したDMF20部を滴下する。5-10℃で15時間攪拌反応させる。反応終了後2%炭酸ソーダ水溶液500部で希釈し、トルエン100部を追加し分液する。トルエン層を水洗し無水硫酸ソーダで乾燥後トルエンを減圧留去して油分を得る。これをジオキサン100部に溶解し濃塩酸10部を加え攪拌反応させエステル基を加水分解する。5%炭酸ソーダ水溶液で中和し析出した結晶を濾過し水洗乾燥して5-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシウンデカノイルオキシ)イソフタール酸の粗製品を得る。アルコールで再結晶して精製品を得る。

【0086】実施例3

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射実施例2で得られたポリアミド化合物(2)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製す

る。実施例1に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0087】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 10部、エマールNC（アニオン界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水8.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.5MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0088】ポリアミド化合物（2）の別途合成方法
4-（4'-ジメチルアミノフェニルアゾ）フェノキシウンデカン酸8.5部と塩化チオニル9.6部をトルエン30部中で室温で5時間攪拌反応させる。その後減圧下に過剰の塩化チオニルを留去し、氷水で冷却しながらポリ（イミノ-5-オキシイソフタロイルイミノ-1,4-（3,5-ジエチル）フェニレン-メチレン-1,4-（3,5-ジエチル）フェニレン4.6部とピリジン9.6部をNMP100部に溶解した液を滴下する。5-10℃で15時間攪拌反応させる。反応終了後2%炭酸ソーダ水溶液500部で希釈し、トルエンを留去した後析出した結晶を濾過し水洗乾燥する。粗製ポリアミドを少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈して再沈殿精製する。このものはNMR測定から約50%のオキシ基が4-（4'-ジメチルアミノフェニルアゾ）フェノキシウンデカノイル基で置換されていることが明らかであった。

【0089】実施例4

ポリアミド化合物（2）の別途合成方法

4-（4'-ジメチルアミノフェニルアゾ）フェノキシウンデカン酸8.5部をジメチルホルムアミド200部中に加熱溶解し、20℃に冷却する。これにポリ（イミ

ノ-5-オキシイソフタロイルイミノ-1,4-（3,5-ジエチル）フェニレン-メチレン-1,4-（3,5-ジエチル）フェニレン9.1部を加え溶解する。更に2-クロロ-1,3-ジメチルイミダゾリウムクロライド3.4部、ピリジン3.4部を添加し、20-22℃で20時間攪拌反応させる。反応終了後少量の不溶解物を濾過する。濾液を2%炭酸ソーダ水溶液500部で希釈し、析出した粗製ポリアミドを濾過し水洗乾燥する。粗製ポリアミドを少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈して再沈殿精製する。このものはNMR測定から約90%のオキシ基が4-（4'-ジメチルアミノフェニルアゾ）フェノキシウンデカノイル基で置換されていることが明らかであった。

【0090】光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射

上記合成方法で得られたポリアミド化合物（2）精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例1に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0091】会合性二色性色素膜の作製

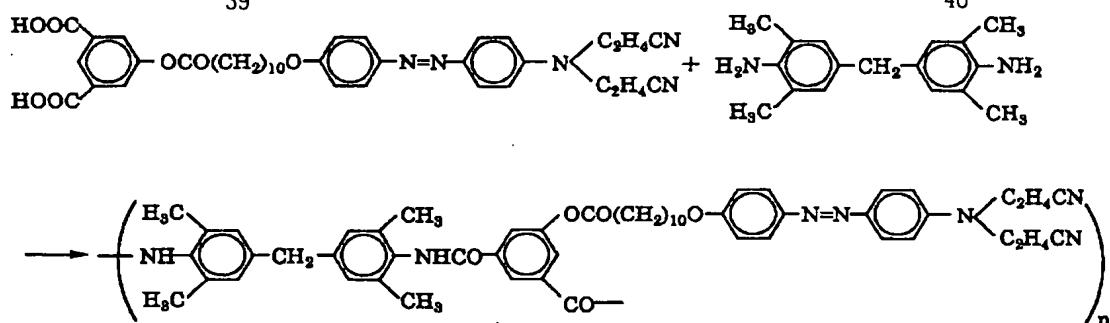
C.I. Direct Blue 67を3部、エマルゲン108（ノニオン界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0092】実施例4と同様にして表1に示すポリアミド化合物が得られ、それについても同様の光配向効果が得られる。

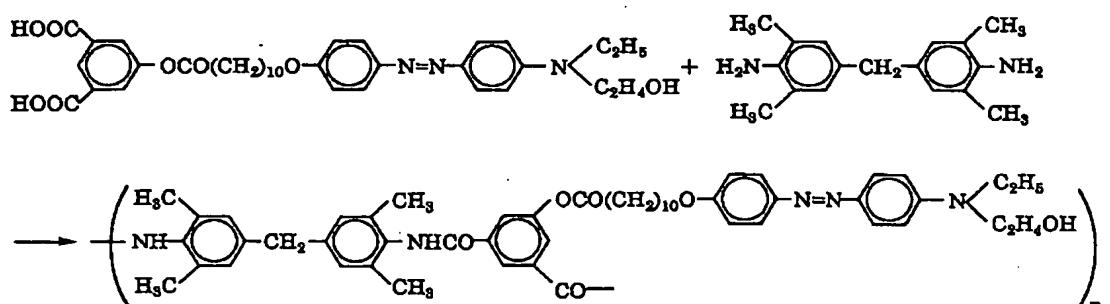
表1

【0093】

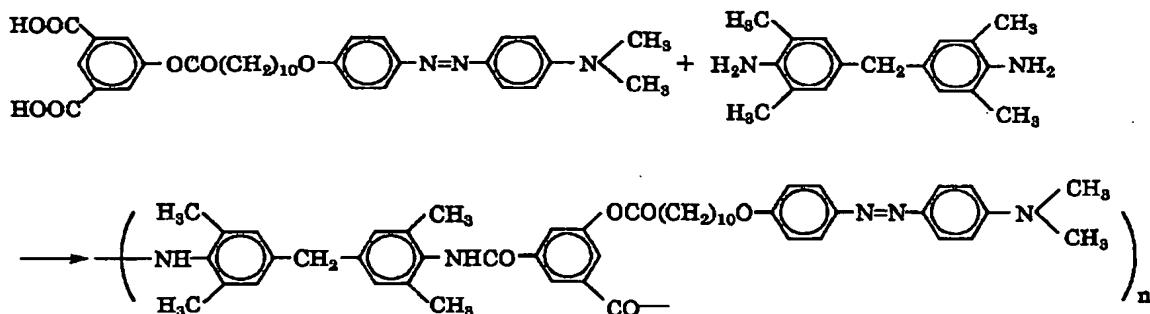
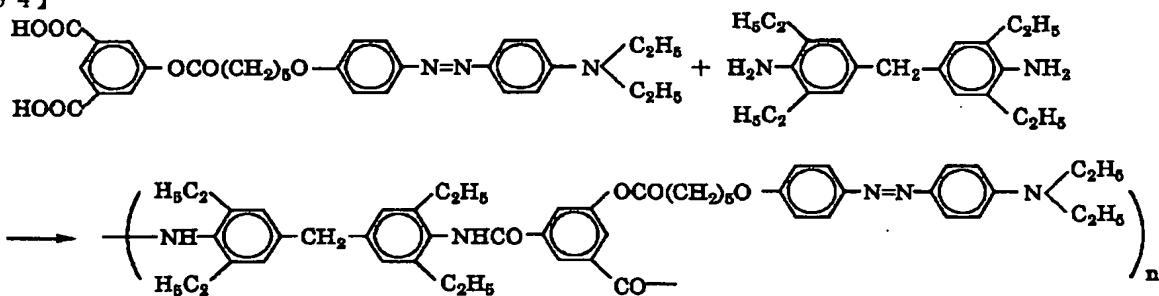
39



40

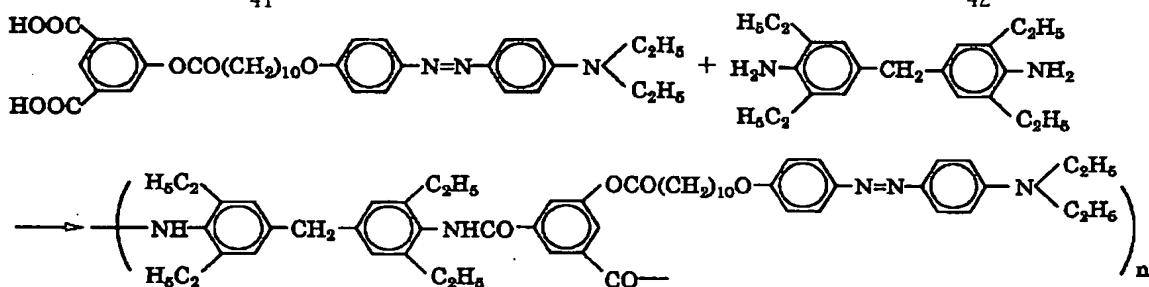


【0094】

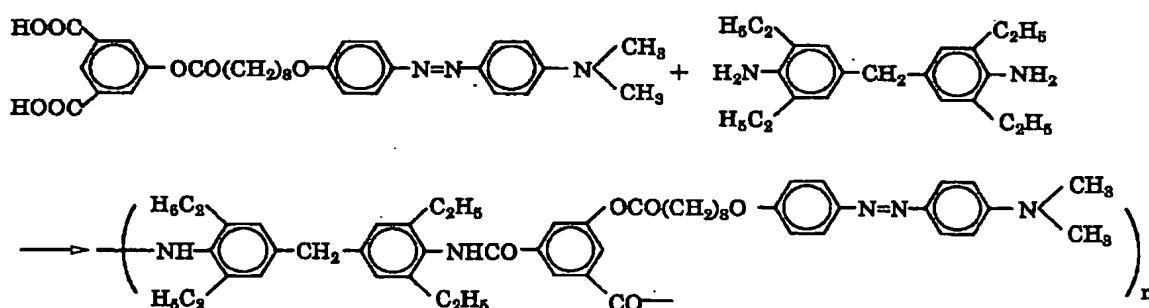


【0095】

41



42



【0096】実施例5

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射
下記ポリアミド化合物（3）精製品2部をNMP 9.8部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンドルコートし、180℃にて10分間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高圧水銀ランプ（500W/h）を使用し550nmカットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0097】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 3部、エマルゲン108（ノニオニ界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水9.6.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0098】ポリアミド化合物（3）の合成

NMP 5.0部中に5-(4'-ジメチルアミノナフチルアゾ)イソフタール酸3.5部、4,4'-ジアミノ-3,5,3',5'-テトラエチルジフェニルメタン（TEDPM）3.1部を加え攪拌溶解する。次いでト

20 リフェニルfosfaイト9.3部、ピリジン2.4部を加え、100℃にて10時間攪拌反応する。反応終了後水5.0部を加え、上澄み液をデカンテーションで除き2%炭酸ソーダ水溶液10.0部を加え一晩攪拌し、結晶化させる。生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリアミド化合物（3）（ポリ{イミノ-5-[4-(ジメチルアミノ)ナフチルアゾ]イソフタロイルイミノ-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレンメチレン-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレン}）3.5部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈し再沈殿精製する。

【0099】上記ポリアミド化合物（3）の原料として使用した5-(4'-ジメチルアミノナフチルアゾ)イソフタール酸の合成

冰水10.0部中に5-アミノイソフタール酸9.05部、6N塩酸1.7部を加え冰水で冷却する。亜硝酸ソーダ3.45部を水1.0部に溶解し、5℃以下で添加してジアゾ化する。別に、1-N、N-ジメチルナフチルアミン8.9部、6N塩酸8.5部、冰水6.0部のカップリング溶液を調製し冰水で冷却する。このカップリング溶液中に5℃以下で上記ジアゾニウム溶液を添加し、2%炭酸ソーダ溶液を加えてpH4~6を保ちながら10℃以下で終夜攪拌する。析出した結晶を濾過し水洗乾燥してモノアゾ色素5-(4'-ジメチルアミノナフチルアゾ)イソフタール酸15.8部を得る。

【0100】実施例6

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射
下記ポリアミド化合物（4）精製品2部をNMP 9.8部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例1に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、超高圧水銀ランプ（500W/h）を使用し500nmカットオフフィルタ

50 を加え攪拌溶解する。次いでト

一で可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0101】会合性二色性色素膜の作製

Benzopurpurine 4Bを1部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水9.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティング器を用いて塗布した。ロールコーティング器はあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0102】ポリアミド化合物(4)の合成

NMP50部中に5-(4'-メトキシナフチルアゾ)イソフタール酸3.5部、4,4'-ジアミノ-3,5,3',5'-テトラエチルジフェニルメタン(TEDPM)3.1部を加え攪拌溶解する。次いでトリフェニルfosfait9.3部、ピリジン2.4部を加え、100℃にて10時間攪拌反応する。反応終了後水50部を加え、上澄み液をデカンテーションで除き2%炭酸ソーダ水溶液100部を加え一晩攪拌し、結晶化させる。生成した結晶を濾過し水洗乾燥して、ポリアミド化合物(4)(ポリ[イミノ-5-(4-ジメトキシナフチルアゾ)イソフタロイルイミノ-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレンメチレン-1,4-(3,5-ジエチル)フェニレン])3.5部を得る。少量のNMPに加熱溶解しメタノールで希釈し再沈殿精製する。

【0103】上記ポリアミド化合物(4)の原料として使用した5-(4'-メトキシナフチルアゾ)イソフタール酸の合成

水40部中に5-アミノイソフタール酸ジエチルエテル12.6部、6N塩酸18部を加え氷水で冷却する。亜硝酸ソーダ3.67部を水10部に溶解し、5℃以下で添加してジアゾ化する。別に、1-ナフトール7.7部、炭酸ソーダ6.5部、水60部のカップリング溶液を調製し氷水で冷却する。このカップリング溶液中に5℃以下で上記ジアゾニウム溶液を添加し、10℃以下で終夜攪拌する。次いで、6N塩酸12部を加え濾過し水洗乾燥してモノアゾ色素5-(4'-オキシナフチルアゾ)イソフタール酸ジエチルエテル20.7部を得る。次に、DMF60部中に上記モノアゾ色素12.5部、炭酸ソーダ2.9部、トルエンスルホン酸メチル10.0部を仕込み100℃で10時間攪拌反応する。反応後水120部を加え終夜攪拌する。析出した結晶を濾

過し水洗する。更に、このウェットケーキをメタノール70部中に苛性ソーダ3.3部を溶解した溶液中に仕込み55-65℃で4時間攪拌反応する。反応後水200部を加えて完全溶解するのを確認して6N塩酸を加えて中和し析出する結晶を濾過水洗乾燥して、5-(4'-メトキシナフチルアゾ)イソフタール酸5.6部を得る。

【0104】実施例7

ポリイミド(1)の合成及び薄膜の調製

10 4-ジメチルアミノ-4'-ジ(アミノ)エチルアミノフェニルアゾベンゼン3.26部、N-メチル-2-ピロリドン60部を四つ口フラスコに仕込み水冷下窒素を吹き込みながら攪拌溶解する。次いでシクロヘキサン-1,2,3,4-テトラカルボン酸無水物2.1部を少量ずつ添加する。添加終了後水冷下4時間、60℃で10時間反応させポリアミック酸溶液を得る。これにN-メチル-2-ピロリドン40部を追加して5%ポリアミック酸溶液を調整し、ガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンドルコートし、200℃で1時間加熱して該ポリイミド薄膜を得る。超高压水銀ランプ(500W/hr)を使用し550nmカットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後ストライプ状のマスクを介して該ポリイミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0105】会合性二色性色素膜の作製

30 C.I. Direct Blue 67 1部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーティング器を用いて塗布した。ロールコーティング器はあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30℃、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0106】実施例8

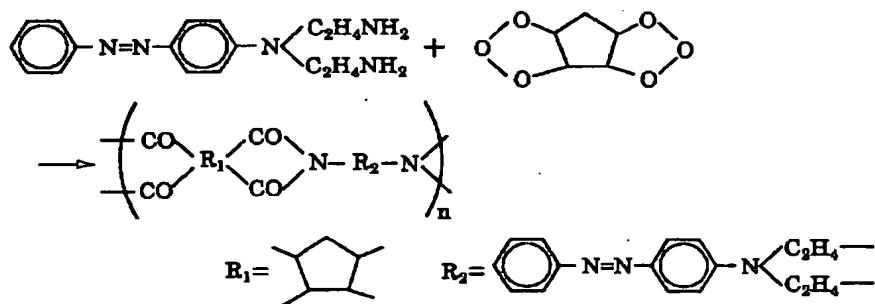
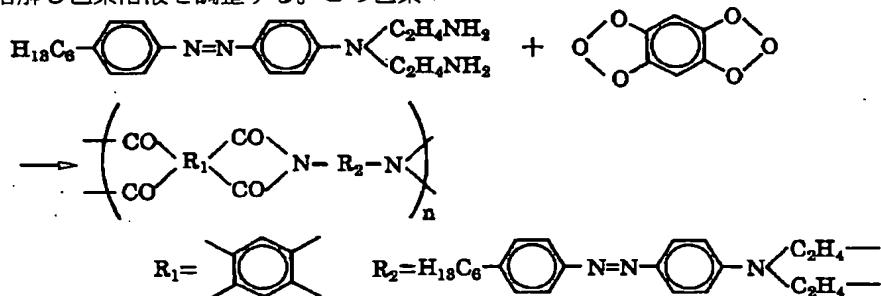
ポリイミド(2)の合成及び薄膜の調製

N、N-ジアミノエチル-4-(4'-ジメチルアミノフェニルアゾ)フェノキシ)ウンデカノイルオキシアニリン3.01部、N-メチル-2-ピロリドン60部を四つ口フラスコに仕込み水冷下窒素を吹き込みながら攪拌溶解する。次いで4,4'-オキシジフタル酸無水物1.55部を少量ずつ添加する。添加終了後水冷下4時間、60℃で10時間反応させポリアミック酸溶液を得る。これにN-メチル-2-ピロリドン30部を追加して5%ポリアミック酸溶液を調整し、ガラス

基板上に乾燥膜厚約 $0.6\text{--}0.7\mu\text{m}$ となるようにスピンコートし、 200°C で1時間加熱して該ポリイミド薄膜を得る。超高圧水銀ランプ(500W/h)を使用し 550nm カットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後ストライプ状のマスクを介して該ポリイミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に 50cm の距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0107】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 1部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素*



【0110】

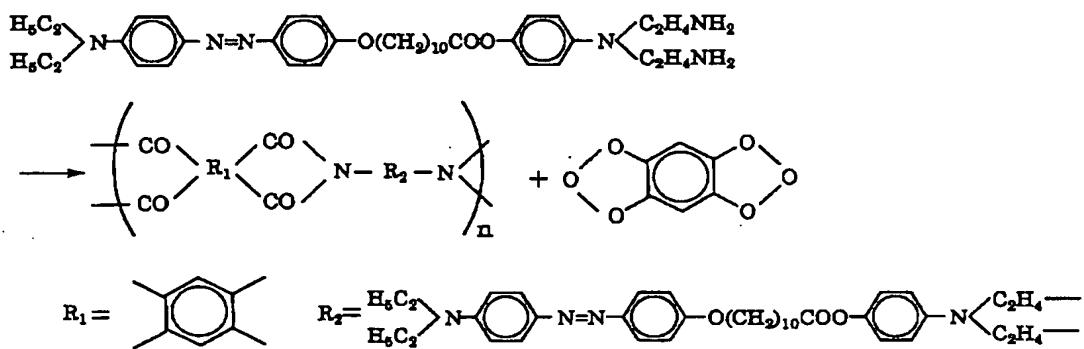
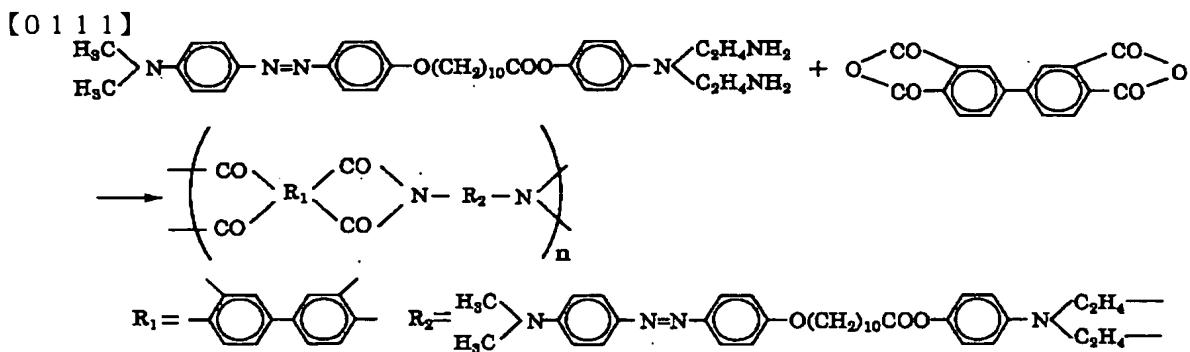
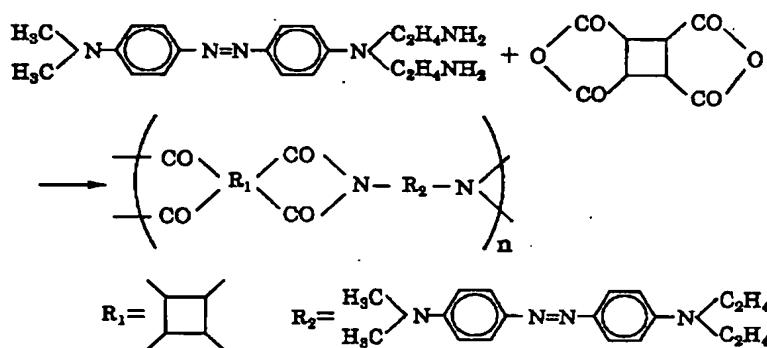
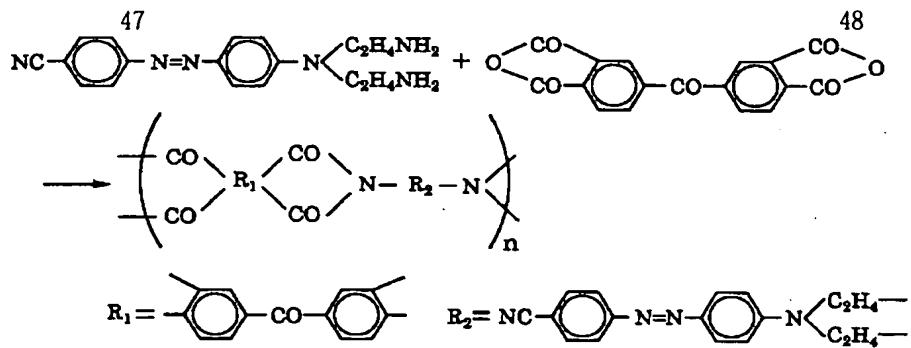
* 溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を 0.2MPa に調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は 30°C 、 60% RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0108】その他のポリイミドの合成例

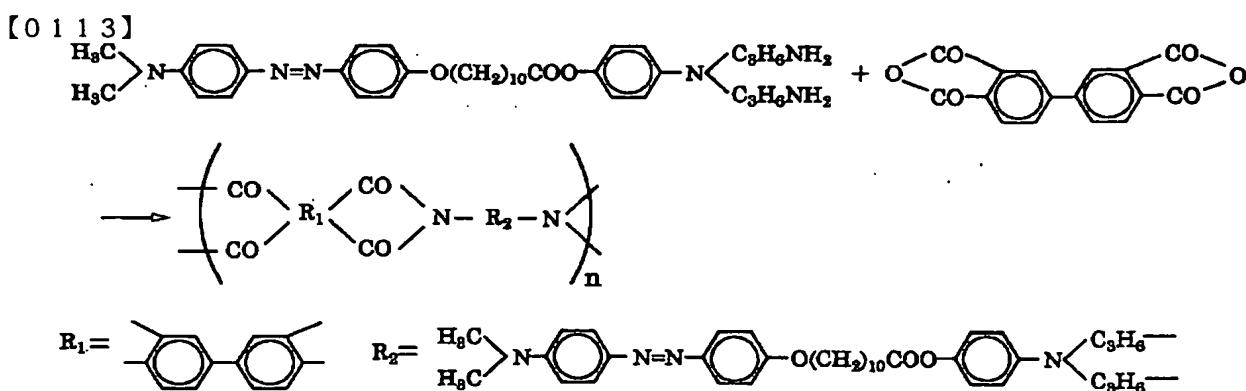
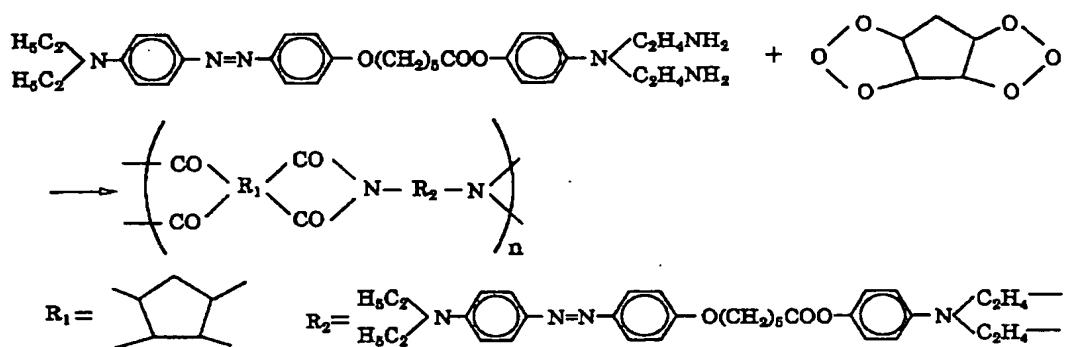
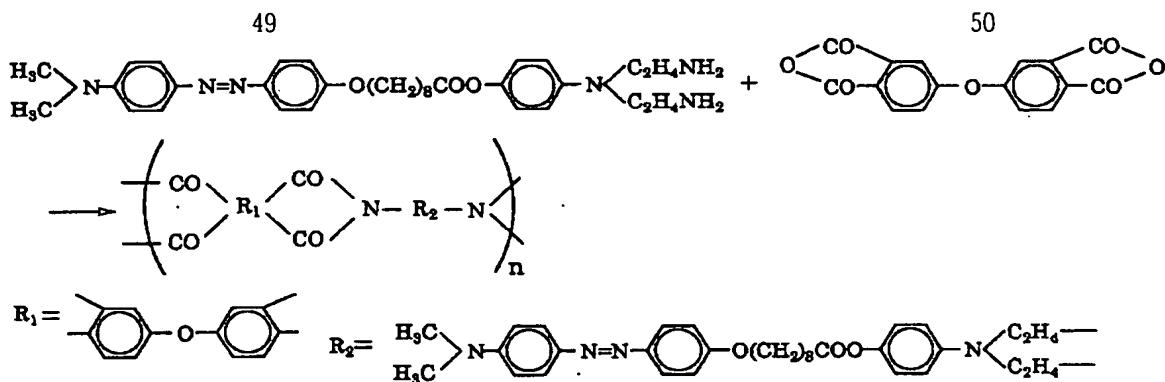
実施例7、8に準じて下記のジアミンとテトラカルボン酸無水物を反応させて、表2に示すポリイミドを得ることが出来る。それらについても同様の光配向効果が得られる。

表2

【0109】



[0 1 1 2]



【0114】実施例9

実施例1において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例1と同様にして得られる直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図4に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポリアミド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0115】会合性二色性色素膜の作製

C. I. Direct Blue 1を1部、C. I. Direct Blue 67を1部、C. I. Direct Red 79を0.5部、C. I. Direct Orange 39を0.5部、エマルゲン108(ノニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水96.8部に

加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーティングする。ロールコーティングはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が90°異なるストライプ状の偏光素子を得た。

【0116】実施例10

実施例 4において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例 4と同様にして得られる直線偏光を図 3に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に 50 cmの距離から 1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図 4に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポリアミド

ド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0117】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 83を1部、C.I. Direct Blue 67を1部、C.I. Direct Red 2を0.5部、C.I. Direct Orange 39を0.5部、エマルゲン108（ノニオン界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が90°異なるストライプ状の偏光素子を得た。

【0118】実施例11

実施例1において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例1と同様にして得られる直線偏光を該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。

【0119】会合性二色性色素膜の作製。

C.I. Direct Blue 15を3部、エマルゲン108（ノニオン界面活性剤：花王（株）製）0.02部を脱イオン水6.98部に加熱溶解し青色色素溶液を調製する。次にC.I. Direct Red 28を3部、エマルゲン108（ノニオン界面活性剤：花王（株）製）0.02部を脱イオン水6.98部に加熱溶解し赤色色素溶液を調製する。更にC.I. Direct Green 85を3部、エマルゲン108（ノニオン界面活性剤：花王（株）製）0.02部を脱イオン水6.98部に加熱溶解し緑色色素溶液を調製する。この色素溶液をスクリーン印刷法でストライプ状に青、赤、緑それぞれ別に上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に印刷し、40°C、60%RHの条件下に乾燥して、本発明の青、赤、緑のストライプ状の偏光素子を得る。

【0120】実施例12

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射。実施例1で得られたポリアミド化合物（1）精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるようにスピンドルコートし、100°Cにて2時間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高压水銀ランプ（500W/h）を使用し500nmカットオフフィルターで可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

方向に配列させる。

【0121】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 5部、エマールE-27C（ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム：アニオン界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水94.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.3MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。吸収極大波長における二色性比は、25であった。

【0122】実施例13

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射実施例2で得られたポリアミド化合物（2）精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0123】会合性二色性色素膜の作製1

C.I. Direct Blue 67 5部、エマールE-27C（アニオン界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水94.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0124】会合性二色性色素膜の作製2

Benzopurpurine 4Bを1部、エマールE-27C（アニオン界面活性剤：花王（株）製）0.2部を脱イオン水98.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。吸収極大波長における二色性比は、30であった。

【0125】実施例14

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射

実施例2で得られたポリアミド化合物(2)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0126】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 10部、エマール20CM(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水89.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.5MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0127】実施例15

ポリアミド化合物(2)の合成

前記実施例4と同様にして、ポリアミド化合物(2)を合成した。このものはNMR測定から約90%のオキシ基が4-(4'-ジメチルアミノ)フェニルアゾフェノキシウンデカノイル基で置換されていることが明らかであった。

【0128】光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射

前記で得られたポリアミド化合物精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間直線偏光を照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0129】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67を3部、エマール20T(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して

本発明のストライプ状の偏光素子を得た。実施例15と同様な方法により、前記した表1のポリアミド化合物についても本発明のストライプ状の偏光素子を得ることができる。

【0130】実施例16

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射
実施例5で得られたポリアミド化合物(3)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。次にガラス基板上に乾燥膜厚約0.6-0.7μmとなるよう10にスピンドルコートし、180°Cにて10分間加熱乾燥して該ポリアミド薄膜を形成する。超高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し550nmカットオフフィルターで可視光とし、更に偏光板を通して直線偏光とした後該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0131】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 3部、エマールNC-35(ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水96.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーティングロールを用いて塗布した。ロールコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して20本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0132】実施例17

光活性基含有ポリアミド薄膜の作製及び直線偏光照射
実施例6で得られたポリアミド化合物(4)精製品2部をNMP98部に溶解し、2%ポリマー溶液を作製する。実施例12に準じて該ポリアミド薄膜を形成し、超高圧水銀ランプ(500W/hr)を使用し500nmカットオフフィルターで可視光とし更に偏光板を通して直線偏光とした後、該ポリアミド薄膜を形成したガラス30基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、ストライプ状のマスクを介して異なる偏光軸を有する直線偏光を同じように照射して、部分的に光活性基の分子軸を異なる方向に配列させる。

【0133】会合性二色性色素膜の作製

Benzopurpurine 4Bを1部、レベノールWX(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.2部を脱イオン水98.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に枚葉基板用ローリングロールを用いて塗布した。ローリングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して50本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

ルコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0134】実施例18

ポリイミド(1)の合成及び薄膜の調製

実施例7と同様にして、ポリイミド(1)の合成及び薄膜の調製を行い、ポリイミド薄膜基板を得た。

【0135】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 1部、エマールAD-25R(ラウリル硫酸アンモニウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0136】実施例19

ポリイミド(2)の合成及び薄膜の調製

実施例8と同様にして、ポリイミド(2)の合成及び薄膜の調製を行い、ポリイミド薄膜基板を得た。

【0137】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 67 1部、エマールE-27C(ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム:アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水8.98部に加熱溶解し色素溶液を調整する。この色素溶液を上記ポリイミド薄膜基板の膜面上にロールコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明のストライプ状の偏光素子を得た。

【0138】表2に示すポリイミドを用いて、実施例18、19に準じて会合性二色性色素膜を作成することにより、本発明のストライプ状の偏光素子を得ることができる。

【0139】実施例20

実施例12において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例12と同様にして得られる直線偏光を図4に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して、該ボ

リアミド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0140】会合性二色性色素膜の作製

C.I. Direct Blue 1を1部、C.I. Direct Blue 67を1部、C.I. Direct Red 79を0.5部、C.I. Direct Orange 39を0.5部、エマール20C(ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム:花王(株)製)0.2部を脱イオン水9.6.8部に加熱溶解し色素溶液を調

10 製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が90°異なるストライプ状の偏光素子を得た。

【0141】実施例21

実施例15において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例15と同様にして得られる直線偏光を図3に示されるストライプ状のマスクを介して該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。次いで、90°回転した直線偏光を図4に示されるストライプ状のマスクを介して、該ポリアミド薄膜塗布基板の未露光部の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を前記分子軸と90°異なる方向に配列させる。

【0142】会合性二色性色素膜の作製

30 C.I. Direct Blue 83を1部、C.I. Direct Blue 67を1部、C.I. Direct Red 2を0.5部、C.I. Direct Orange 39を0.5部、エマール20C 0.2部を脱イオン水9.6.8部に加熱溶解し色素溶液を調製する。この色素溶液を上記ポリアミド薄膜基板の膜面上にロールコーテーを用いて塗布した。ロールコーテーはあらかじめコーティングロールと基板間の位置を微調整してロールと基板間の押し圧を0.2 MPaに調整した。圧力の測定は富士フィルムプレスケールによって測定した。塗布した基板は30°C、60%RHの条件下に乾燥して本発明の偏光軸が90°異なるストライプ状の偏光素子を得た。

【0143】実施例22

実施例12において作製したポリアミド薄膜塗布基板に、実施例12と同様にして得られる直線偏光を該ポリアミド薄膜を形成したガラス基板の膜面上に50cmの距離から1分間照射して、偏光照射部分の光活性基の分子軸を一定方向に配列させる。

【0144】会合性二色性色素膜の作製

50 C.I. Direct Blue 15を3部、エマール20C(アニオン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水

6. 98部に加熱溶解し青色色素溶液を調製する。次に
C.I. Direct Red 28を3部、エマール20C(アニオン
界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水
6. 98部に加熱溶解し赤色色素溶液を調製する。更に
C.I. Direct Green 85を3部、エマール20C(アニオ
ン界面活性剤:花王(株)製)0.02部を脱イオン水
6. 98部に加熱溶解し緑色色素溶液を調製する。この
色素溶液をスクリーン印刷法でストライプ状に青、赤、
緑それぞれ別に上記ポリアミド薄膜基板の膜面上に印刷
し、40°C、60%RHの条件下に乾燥して、本発明の
青、赤、緑のストライプ状の偏光素子を得る。

10

【0145】

【発明の効果】本発明によれば、直線偏光を照射した光
活性基を有する液晶性樹脂薄膜層に二色性分子をマイ
クロパターン状に配列させるだけで偏光素子が得られる。
延伸操作が必要ないのでガラス基板のような延伸不可能
な基板上にも直接偏光素子を作り込むことが可能とな
った。又、照射する直線偏光の偏光軸を変えるだけで二色
性分子の配列を変えることが可能であり、そのため基板*

* 上に偏光軸が異なるマイクロパターン偏光素子の製造が
可能となった。この基板を使用した液晶表示素子は容易
に立体画像表示が可能となる。

【0146】

【図面の簡単な説明】

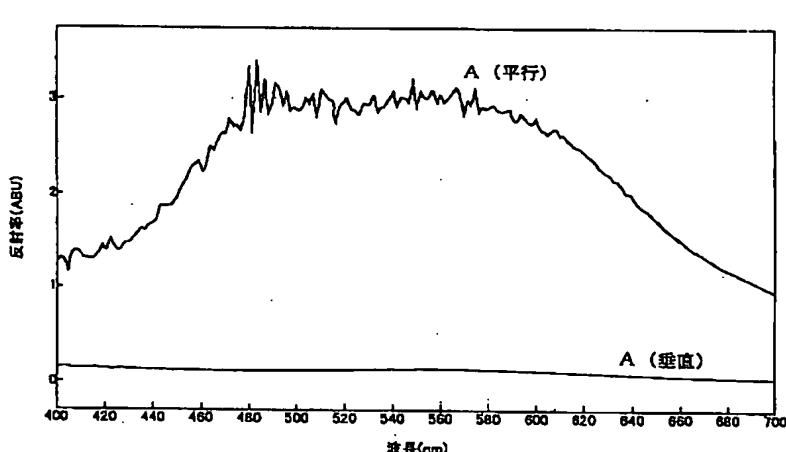
【図1】実施例1で得られた偏光素子の可視吸収スペク
トル(図においてA(平行)は偏光軸が配向色素の分子
長軸と平行な場合の吸光度を、又A(垂直)は偏光軸が
配向色素の分子長軸と垂直な場合の吸光度をそれぞれ示
す。以下の図において同様)

【図2】実施例2で得られた偏光素子の可視吸収スペク
トル

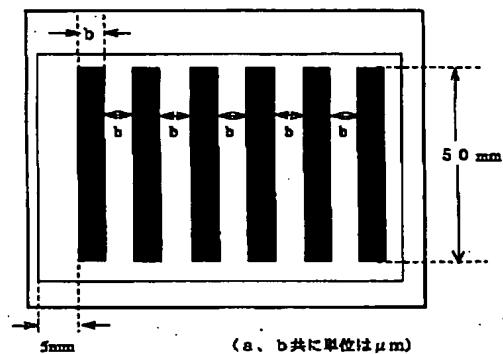
【図3】長さ50mm、幅aμmの遮光部がbμmの間
隔をおいて並んでいるテスト用マスク

【図4】長さ50mm、幅aμmの遮光部がbμmの間
隔をおいて並んでいるテスト用マスク。b>aであり、
重ね合わせた場合に図3の遮光部と遮光部の間に図4の
遮光部が入る位置関係にある。

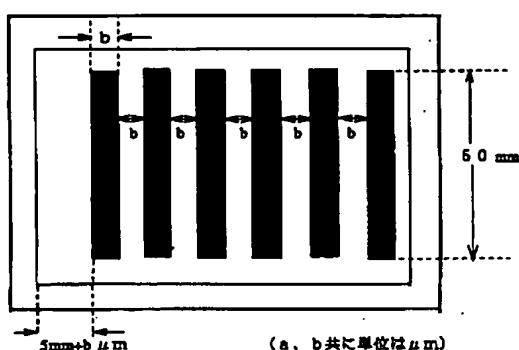
【図1】



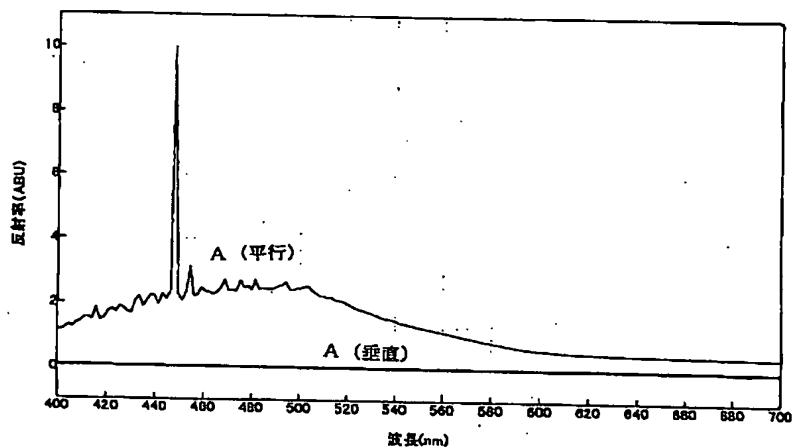
【図3】



【図4】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 玉置 敬

茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人
産業技術総合研究所つくばセンター内

Fターム(参考) 2H049 BA05 BA22 BB02 BC08 BC09

BC22

2H091 FA07X FA07Z FB02 FC23

GA01 LA12 LA17 LA30 MA01